12

EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG

(a) Anmeldenummer: 87810430.6

Anmeldetag: 27.07.87

(9) int. Cl.4: C 07 F 17/00 C 08 F 2/50, G 03 C 1/68

30 Priorität: 01.08.86 CH 3101/88

(43) Veröffentlichungstag der Anmeldung: 03.02.88 Patentblatt 88/05

Benannte Vertragsstaaten:
AT BE CH DE ES FR GB IT LI NL SE

Anmelder: CIBA-GEIGY AG Klybeckstrasse 141 CH-4002 Basel (CH) (2) Erfinder: Riedlker, Martin, Dr. Gsteitenrainweg 75 CH-4125 Riehen (CH)

> Steiner, Eginhard, Dr. Obere Hofaackerstrasse 3 CH-4414 Füllinsdorf (DE)

Beyeler, Harry Marignanostrasse 35 CH-4059 Basel (CH)

Rembold, Manked, Dr. Im Aeschield 21 CH-4147 Aesch (CH)

Sitek, Franciszek, Dr. Grossmattweg 11 CH-4106 Therwil (CH)

(3) Titanocene und deren Verwendung.

(f) Titanocene mit z.B. η-Cyclopentadlenylliganden, in denen ein oder zwei carbo- oder heterocyclische aromatische Ringe an das Titan gebunden sind, wobel die aromatischen Ringe in mindestens einer der beiden Orthostellungen zur Metall-Kohlenstoffbindung mit Fluor substituiert und durch mindestens einen gegebenenfalls verätherten oder veresterten Polyoxaalkylenrest substituiert sind, eignen sich als Photoinitiatoren für die Photopolymerisation von ethylenisch ungesättigten Substituten.

Interference 105,362

Dow Exhibit 1030

Beschreibung

Titanocene und deren Verwendung

Die vorliegende Erfindung betrifft Titanocene mit fluorierten aromatischen Resten, eine photopolymerisierbare Zusammensetzung aus äthylenisch ungesättigten Verbindungen, die diese Titanocene als Photoinitiatoren enthalten, ein mit dieser Zusammensetzung beschichtetes Substrat und ein Verfahren zur Herstellung photographischer Reliefabbildungen unter Verwendung dieses beschichteten Substrates.

Aus der EP-A-0 122 223 ist es bekannt, dass Titanocene mit Fluorarylliganden ausgezeichnete Photoinitilatoren sind. Diese Titanocene sind kristallin und daher anwendungstechnisch nicht immer problemios zu verarbeiten. Die mit diesen Titanocenen erzielbaren Lichtempfindlichkeiten werden durch deren Löslichkeiten in lichtempfindlichen Zusammensetzungen beeinflusst.

Gegenstand der vorliegender Erfindung sind Titanocene der Formel I

$$R^1 = \frac{R^1}{1 - R^2}$$
 (I),

stehen, worin $X \leftarrow CH_2 \rightarrow_n$ mit n=1, 2 oder 3, gegebenenfalls durch Phenyl substituiertes Alkyliden mit 2 bis 12 C-Atomen, Cycloalkyliden mit 5 bis 7 Ringkohlenstoffatomen, SiR 4 2 oder SnR 4 2 ist, und R 4 C₁-C₁₂-Alkyl, C₅-C₁₂-Cycloalkyl, C₅-C₁₅-Aryl oder C₇-C₁₅-Aralkyl bedeutet,

R² einen 6-gliedrigen carbocyclischen oder 5- oder 6-gliedrigen heterocyclischen aromatischen Ring bedeutet, der in mindestens einer der beiden ortho-Stellungen zur Metalikohlenstoffbindung durch Fluoratome substituiert ist und wobei der aromatische Ring weitere Substituenten enthalten kann, oder R² und R³ zusammen einen Rest der Formel III bedeuten,

-Q-Y-Q- (III)

in dem Q für einen carbocyclischen aromatischen Ring steht, wobei die beiden Bindungen jeweils in Orthostellung zur Y-Gruppe stehen und die Metastellung zur Y-Gruppe jeweils durch ein Fluoratom substituiert ist und wobei Q weitere Substituenten enthalten kann, und Y CH₂, Alkyliden mit 2 bis 12 C-Atomen, Cycloalkyliden mit 5 bis 7 Ringkohlenstoffatomen, eine direkte Bindung, NR⁴, O, S, SO, SO₂, CO, SiR⁴₂ oder SnR⁴₂ bedeutet und R⁴ die zuvor angegebene Bedeutung hat,

R³ die Bedeutung von R² hat oder Alkinyl, substituiertes oder unsubstituiertes Phenylalkinyl, N₃, CN, SiR⁴₃ oder SnR⁴₃ bedeutet, wobei die Titanocene dadurch gekennzeichnet sind, dass R² mindestens einen gegebenenfalls verätherten oder veresterten (Polyoxaalkylen)rest enthält, wobei dieser Rest entweder direkt oder über eine Brückengruppe an den aromatischen Ring gebunden ist.

Bei den Gruppen R1 handelt es sich bevorzugt um gleiche Reste. Als Substituenten kommen für R1 in Frage: lineares oder verzweigtes Alkyl oder Alkoxy mit 1 bis 18, besonders 1 bis 12 und insbesondere 1 bis 6 C-Atomen, und Alkenyl mit 2 bis 18, besonders 2 bis 12, und insbesondere 2 bis 6 C-Atomen, wie z.B. Methyl, Ethyl, Propyl, Isopropyl, n-Butyl, tert.-Butyl, Pentyl, Hexyl, Octyl, Decyl, Dodecyl, Tetradecyl, Hexadecyl, Octadecyl und entsprechende Alkenyl-und Alkoxygruppen; Cycloalkyl und Cycloalkenyl mit 5 bis 8 Ringkohlenstoffatomen wie z.B. Cyclopentyl, Cyclohexyl, Cycloheptyl, Methylpentyl und Methylcyclohexyl; Aryl mit 6 bis 16 C-Atomen und Aralkyl mit 7 bis 16 C-Atomen wie z.B. Phenyl, Naphthyl, Benzyl und Phenyläthyl; Nitril und Halogen, besonders F, Cl und Br.

Die Reste R¹ können bis zu 3, besonders aber 1, Substituenten enthalten, insbesondere sind beide R¹ Cyclopentadienyle- oder Methylcyclopentadienyle-Reste.

X in Formel II enthält in seiner Bedeutung als Alkyliden bevorzugt 2 bis 6 C-Atome. Beispiele für Alkyliden, das gegebenenfalls durch Phenyl substituiert sein kann, und Cycloalkyliden sind Ethyliden, Propyllden, Butyilden, Hexyliden, Phenylmethylen, Diphenylmethylen, Cyclopentyliden und Cyclohexyliden. R4 in der Gruppe X in seiner Bedeutung als Alkyl enthält bevorzugt 1 bis 6 C-Atome, und ist z.B. Methyl, Ethyl, Propyl, Butyl oder Hexyl, und ist in seiner Bedeutung als Cycloalkyl bevorzugt Cyclopentyl oder Cyclohexyl, in seiner Bedeutung als Aryl bevorzugt Phenyl und in seiner Bedeutung als Aralkyl bevorzugt Benzyl. Besonders bevorzugt ist X Methylen.

Bei R² in seiner Bedeutung als 6-gliedriger carbocyclischer aromatischer und Fluor-substituierter Ring kann

es sich um fluorsubstituiertes Inden, Inden, Fluoren, Naphthalin und besonders Phenyl handeln. Bevorzugt sind beide Orthostellunger, mit Fluor substituiert, R² als heterocyclischer aromatischer und 5-gliedriger Rest enthält bevorzugt ein Heteroatom und als 6-gliedriger Ring bevorzugt 1 oder 2 Heteroatome.

Die Gruppe R² enthält mindestens einen gegebenenfalls verätherten oder veresterten (Polyoxaalkylen)rest, wobei dieser Rest direkt oder über eine Brückengruppe an den aromatischen Ring gebunden sein kann. Sie kann weitere Ringsubstituenten enthalten, wie z.B. Alkyl, Cycloalkyl, Aryl, Aralkyl, Hydroxyl, Alkoxy, Carboxyl, Alkoxycarbonyl, Halogen oder Cyano. Beispiele hierfür sind: Ilneares oder verzweigtes Alkyl oder Alkoxy mit bevorzugt 1 bis 18, insbesondere 1 bis 6 C-Atomen, z.B. Methyl, Ethyl, Propyl, Butyl, Pentyl, Hexyl und die entsprechenden Alkoxygruppen, besonders Methyl und Methoxy; Cycloalkyl mit bevorzugt 5 oder 6 Ringkohlenstoffatomen, Aryl mit bevorzugt 6 bis 16 C-Atomen und Aralkyl mit bevorzugt 7 bis 16 C-Atomen wie z.B. Cyclopentyl, Cyclohexyl, Phenyl oder Benzyl; Hydroxyl, Carboxyl, CN, Halogen, wie F, Cl oder Br und tertiäres Amino, das mit Alkylhalogeniden, wie Methylchlorid, -bromid oder -jodid quaternisiert sein kann. Beispiele für Amino sind Dimethylamino, Pyrrolldyl, Piperidyl, Piperazyl, Morpholyl, N-Methylpiperazyl; Alkoxycarbonyl mit bevorzugt 1 bis 18, besonders 1 bis 6 C-Atomen in der Alkoxygruppe; Aminocarbonyl mit ein oder zwei Alkylgruppen mit 1 bis 12 C-Atomen in der Aminogruppe oder Aminocarbonyl mit heterocyclischen Aminen, wie Pyrrolidin, Piperidin, Piperazin, N-Methylpiperazin und Morpholin; tertiäres Aminoalkyl mit bevorzugt C₁-C₆-Alkylgruppen, das mit Alkylhalogeniden quaternisiert sein kann.

R³ enthält in seiner Bedeutung als Alkinyl bevorzugt 2 bis 6C-Atome, Belspiele sind Ethinyl und Propargyl. Als Phenylalkinyl ist R³ bevorzugt Phenylethinyl. Substituenten für R³ als Phenylalkinyl sind z,B. Haiogen, wie F, Cl, Br, tertiär-Amino und Alkoxy mit 1 bis 6 C-Atomen, Carboxyl, OH und CN. R³ hat bevorzugt die Bedeutung von R².

in einer bevorzugten Ausführungsform ist in Formel i R² substituiertes 2,6-Difluorphen-1-yl oder R² und R³ zusammen ein substituierter Rest der Formel

worin Y die zuvor angegebene Bedeutung hat, die durch mindestens einen gegebenenfalls verätherten oder veresterten (Polyoxaalkylen)rest substituiert sind, wobei dieser Rest direkt oder über eine Brückengruppe an R² gebunden sein kann. Insbesondere ist R² 2,6-Difluorphen-1-yl, das 1 bis 3 weitere Substituenten enthält, wovon mindestens einer ein gegebenenfalls verätherter oder veresterter (Polyoxalkylen)rest ist, der direkt oder über eine Brückengruppe an R² gebunden ist.

Eine bevorzugte Ausführungsform ist dadurch gekennzeichnet, dass R² und R³ für 2,6-Difluorphen-1-yi stehen, an das mindestens ein gegebenenfalls verätherter Polyoxaalkylenrest direkt oder über eine Brückengruppe gebunden ist, und das weitere 1 oder 2 gleiche oder verschiedene Substituenten enthalten

Eine bevorzugte Gruppe von Metallocenen der Formei I sind solche, worin beide R¹ Cyclopentadienyle oder durch C₁-C₄-Alkyl substituiertes Cyclopentadienyle und R² und R³ Reste der Formei

sind, worin R⁵ und R⁶ unabhängig voneinander H, F, Cl oder Br bedeuten und R⁷ gegebenenfalls veräthertes oder verestertes Polyoxaalkylen ist, das direkt oder über eine Brückengruppe an den Phenylring gebunden ist. R⁵ und R⁶ sind bevorzugt F.

Der Polyoxaalkylenrest ist bevorzugt mit C₁-C₁₈-, besonders C₁-C₁₂-und insbesondere C₁-C₈-Alkyl veräthert oder mit C₁-C₁₈-, besonders C₁-C₁₂- und insbesondere C₁-C₆-Acyl verestert. Belsplele für Alkyl sind Methyl, Ethyl, n-und i-Propyl, n-, i- und t-Butyl, Pentyl, Hexyl, Heptyl, Octyl, Nonyl, Decyl, Undecyl, Dodecyl, Tetradecyl, Hexadecyl, Octadecyl, Belsplele für Acyl sind Formyl, Acetyl, Proplonyl, Trifluoracetyl, Butyryl, Pentanoyl, Hexanoyl, Octanoyl, Dodecanoyl, Benzoyl. Bevorzugt sind verätherte Polyoxaalkylenreste.

Der Polyoxaalkylenrest enthält bevorzugt 1 bis 20, besonders 1 bis 12 und insbesondere 2 bis 6 Oxaalkyleneinheiten. Das Alkylen im (Polyoxaalkylen)rest enthält bevorzugt 2 bis 6, besonders 2 bis 4 C-Atome und stellt insbesondere Ethylen oder 1,2-Propylen dar. Weltere Beispiele sind 1,3-Propylen, 1,2-, 1,3- und 1,4-Butylen, Pentylen und Hexylen, im Polyoxaalkylenrest können auch verschiedene Alkylenreste enthalten sein.

In einer bevorzugten Ausführungsform entspricht der Polyoxaalkylenrest der Formel

20

25

30

45

$$(-c_zH_{2z}O) - R^9$$
,

worin z eine Zahl von 2-6, o eine Zahl von 1 bis 20 und R⁹ H oder C₁-C₁₈-Alkyl bedeuten.

Eine bevorzugte Gruppe der erfindungsgemässen Titanocene ist dadurch gekennzeichnet, dass es sich bei der Brückengruppe um eine Gruppe der Formel -S-, -O-, -OSO₂-, -CH₂O-, -CH(CH₃)O-, -SO₂-, -C(O)O-,

$$-NR^{10} CH_{2}CH_{2}NR^{10} - -NCH_{2}CH_{2}NR^{10}_{2}, -CH_{2}M, -CH_{2}NR^{10}_{10}, -CH_{10}C$$

$$-\text{CH}_2\text{CON}$$
, $-\text{CON}$, $-\text{OC}(0)0-$, $-\text{N}(R^{10})-\text{COO}-$, $-\text{CH}_2\text{N}(R^{10})-\text{COO}-$,

$$-N(R^{10})-CONH-$$
, $-CH_2N(R^{10})-CONH-$, $-C_nN_{2n}OC(0)C_mH_{2m}O-mit n = 0$,

1 oder 2 und m = 1-6,
$$-C_nH_{2n}OSiR_{3-y}^{11}O_y$$
 mit n = 0, 1 oder 2 und y = 1-3 oder $-OCH_2CH_2OSiR_{3-y}^{11}O_y$, mit y = 1-3 handelt, worin R^{10} H,

C₁-C₁₈-Alkyl oder C₁-C₁₈-Acyl und R¹¹ C₁-C₁₂-Alkyl oder Phenyl sind.

- In einer bevorzugten Ausführungsform stellen R⁸ C₁-C₁₂-Alkyl, R¹⁰ H oder C₁-C₁₂-Alkyl und R¹¹ C₁-C₆-Alkyl, z eine Zahl von 2 bis 4 und o eine Zahl von 2 bis 6 der.
 - In einer besonders bevorzugten Gruppe der erfindungsgemässen Titanocene entspricht der über eine Brückengruppe gebundene Polyoxaalkylenrest den Formein

$$-0-(CH2CH2O-)-R9$$

25

$$-N[(CH_2CH_2-O-)-R^9]_2$$

$$-NR^{10}$$
 (CH₂CH₂O \rightarrow) $-R^9$

worin R⁹ C₁-C₁₂-Alkyl bedeutet, R¹⁰ H oder C₁-C₆-Alkyl darstellt und o für eine Zahl von 2 bis 6 steht.

Besonders bevorzugt sind Titanocene der Formel I, worin R¹ Cyclopentadienyl oder Methylcyclopentadienyl ist und R² und R³ Reste der Formel

60

sind, worin R⁵ und R⁶ Wasserstoff oder Fluor bedeuten, o eine Zahl von 2-6 bedeutet und R⁶ C₁-C₁₂-Alkyl bedeutet, insbesondere solche, worin R⁵ und R⁶ Fluor bedeuten.

Beispiele für Titanocene der Formel I sind:

Bis(cyclopentadienyl)-bis[4-{1',4',7'-trioxaundecyl]-2,3,5,6-tetrafluorphenyl]-titan,
Bis(methylcyclopentadienyl)-bis[4-{1',4',7'-trioxaundecyl]-2,3,5,6-tetrafluorphenyl]-titan,
Bis(cyclopentadienyl)-bis[4-{1',4',7',10'-tetraoxadodecyl]-2,3,5,6-tetrafluorphenyl]-titan,
Bis(methylcyclopentadienyl)-bis[3-{1',4',7'-trioxahendecyl]-2,6-difluorphenyl]-titan,
Bis(cyclopentadienyl)-bis[3-{1',4',7',10'-trioxadodecyl]-2,6-difluorphenyl]-titan,
Bis(cyclopentadienyl)-bis[3-{1',4'-dioxapentyl}-2,6-difluorphenyl]-titan.

Die Herstellung der Titanocene der Formel I kann nach bekannten oder analogen Verfahren erfolgen, indem man 1 Mol einer Verbindung der Formel III

15

20

25

30

45

$$\mathbb{R}^1$$
 \mathbb{Z} (III)

worin R1 die angegebene Bedeutung hat und Z für Halogen, besonders Chlor, steht, entweder mit ein Moi LiR2 oder LiR3 und danach mit ein Moi LiR3 bzw. LiR2 umsetzt, oder mit 2 Moi LiR2 umsetzt, wobei R2 die zuvor angegebene Bedeutung hat und R3 Alkinyl, unsubstitulertes oder substituiertes Phenylaikinyl, N3, CH, SiR4s oder SnR43 bedeutet, und danach die Verbindungen der Formel I in an sich bekannter Weise isoliert.

Die bekannten Verfahren sind z.B. in J. Organometal. Chem., 2 (1964) 206-212, J. Organometal. Chem., 4 (1965) 445-446 und in der EP-A-O 122 223 beschrieben.

Die Ausgangsverbindungen der Formel III, in denen Z besonders für Chlor steht, sind bekannt oder können nach analogen Verfahren durch die Umsetzung von TICI4 mit Natriumverbindungen NaR¹ erhalten werden. Die Lithiumverbindungen LIR² und LiR³ sind ebenfalls bekannt oder können nach analogen Verfahren durch die Umsetzung von R²- bzw. R³-Ĥalogeniden, besonders den Bromiden, mit Butyllithium hergestellt werden. Mit Tertläraminomethylgruppen substituierte Derivate erhält man z.B. durch die Umsetzung von entsprechenden Difluordibromphenylverbindungen, die man zunächst in Lithiumdifluorbromphenylverbindungen überführt, danach mit N,N-Dialkylmethylenammoniumchlorid umsetzt, worauf das entstandene Dialkylaminomethyl-difluorbromphenyl mit Butyllithium zur entsprechenden Lithiumverbindung umgesetzt wird.

Die Einführung des gegebenenfalls verätherten oder veresterten Polyoxaalkylenrestes in die R²-Halogenide erfolgt in an sich bekannter Weise. Funktionelle R²-Halogenide, die geeignete Vorläufer für Brückengruppen aufweisen, sind z.B. von L.S. Kobrina in Fluorine chemistry revious, Volume 7, S. 1-114, Marcel Dekker Inc., NY, 1974 beschrieben.

Die Herstellung der Metallocene der Formel I erfolgt im allgemeinen in Gegenwart inerter Lösungsmittel wie z.B. Kohlenwasserstoffen oder Aethern, bei Temperaturen unter -30 bis -100°C, vorzugsweisse -60 bis -90°C und unter Schutzgasatmosphäre. In einer Ausführungsform des Verfahrens wird zunächst LiR² bzw. LiR³ durch Umsetzung der entsprechenden Halogenide in Aether als Lösungsmittel mit Lithiumbutyl bei Temperaturen um -78°C hergestellt. Zu der gekühlten Reaktionsmischung gibt man dann das entsprechende Titanocendihalogenid, entfernt die Kühlung und lässt auf Raumtemperatur erwärmen. Die Reaktionsmischung wird dann, gegebenenfalls nach Zugabe von Lösungsmitteln, filtriert und aus der Lösung durch Ausfällen oder Verdampfen des Lösungsmittels das erfindungsgemässe Titanocen isoliert.

Es handelt sich Im allgemeinen um flüssige, sirupöse bis harzartige, meist orange-gefärbte Verbindungen, die sich durch eine hohe thermische Stabilität auszeichnen und sich erst bei hohen Temperaturen zersetzen. Auch unter Lufteinwirkung sowie unter Einwirkung von Wasser wird keine Zersetzung beobachtet. Die Verbindungen können sehr gut in härtbaren Zusammensetzungen gelöst werden bzw. mit diesen vermischt werden, auch in höheren Mengen, und bleten daher wertvolle anwendungstechnische Vorteile. Die Verbindungen sind auch in Lösungsmitteln sehr gut löslich, und können in Form von Lösungen in härtbare Zuammensetzungen eingearbeitet werden, wonach das Lösungsmittel gegebenenfalls entfernt wird.

Die Verbindungen sind dunkellagerstabil und können ohne Schutzgas gehandhabt werden. Sie eignen sich alleine hervorragend als sehr wirksame Photoinitiatoren für die lichtinduzlerte Polymerisation ethylenisch ungesättigter Verbindungen. Sie zeichnen sich hierbei durch eine sehr hohe Lichtempfindilichkeit und Wirksamkeit über einen grossen Wellenlängenbereich von ca. 200 nm (UV-Licht) bis etwa 600 nm aus. Ferner vermögen die Titanocene auch wirksam die Polymerisation unter dem Einfluss von Warme zu initilieren, wobei

ein Erwärmen auf 170°C bis 240°C zweckmässig ist. Selbstverständlich kann auch Lichteinwirkung und Erwärmung zur Polymerisation benutzt werden, wobei eine Erwärmung nach der Belichtung tiefere Temperaturen, z.B. 80-150°C, zur Polymerisation erlaubt.

Ein weiterer Gegenstand vorliegender Erfindung ist eine durch Strahlung polymerisierbare Zusammensetzung, enthaltend (a) mindestens eine nichtflüchtige, monomere, oligomere oder polymere Verbindung mit mindestens einer polymerisierbaren ethylenisch ungesättigten Doppelbindung und (b) mindestens ein Titanocen der Formel I als Photoinitiator.

Die Zusammensetzungen können weitere Photoinitiatoren (c), z.B. solche vom Typ der Benzilketale, 4-Aroyl-1,3-dioxolane, Dialkoxyacetophenone, α-Hydroxy- oder α-Aminoacetophenone oder Mischungen davon enthalten. Der Vorteil besteht darin, dass man geringere Mengen der erfindungsgemässen Titanocene verwenden kann und trotzdem gleiche oder verbesserte Lichtempfindlichkeiten erzielen kann. Das Gewichtsverhältnis dieser Komponenten (c):(b) kann z.B. von 1:1 bis 30:1, bevorzugt 5:1 bis 15:1 betragen.

Die Zusatzmenge der erfindungsgemässen Titanocene richtet sich Im wesentlichen nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten, deren Löslichkeiten und nach der gewünschten Empfindlichkeit. Im allgemeinen werden 0,01 bis 20, vorzugsweise 0,05-10 und besonders 0,1 bis 5 Gew.% verwendet, bezogen auf die Komponente (a).

Als Komponente (a) kommen solche ethylenisch ungesättigten monomeren, oligomeren und polymeren Verbindungen in Frage, die durch Photopolymerisation zu höhermolekularen Produkten reagieren und hierbei ihre Löslichkeit verändern.

Besonders geeignet sind z.B. Ester von ethylenisch ungesättigten Carbonsäuren und Polyolen oder Polyepoxiden, und Polymere mit ethylenisch ungesättigten Gruppen in der Kette oder in Seitengruppen, wie z.B. ungesättigte Polyester, Polyamide und Polyurethane und Copolymere hiervon, Polybutadien und Butadien-Copolymere, Polyisopren und Isopren-Copolymere, Polymere und Copolymere mit (Meth)Acylgruppen in Seitenketten, sowie Mischungen von einem oder mehreren solcher Polymerer.

Beispiele für ungesättigte Carbonsäuren sind Acrylsäure, Methacrylsäure, Crotonsäure, Itaconsäure, Zimtsäure, ungesättigte Fettsäuren wie Linolensäure oder Oelsäure. Bevorzugt sind Acryl- und Methacrylsäure.

Als Polyole sind aromatische und besonders aliphatische und cycloaliphatische Polyole geeignet. Beispiele für aromatische Polyole sind Hydrochinon, 4,4*-Dihydroxydiphenyl, 2,2-Di(4-hydroxyphenyl)propan, sowie Novolake und Resole. Beispiele für Polyepoxide sind solche auf der Basis der genannten Polyole, besonders der aromatischen Polyole und Epichlorhydrin. Ferner sind auch Polymere oder Copolymere, die Hydroxylgruppen in der Polymerkette oder in Seitengruppen enthalten, wie z.B. Polyvlylalkohol und Copolymere davon oder Polymethacrylsäurehydroxyalkylester oder Copolymere davon, als Polyole geeignet. Weitere geeignete Polyole sind Oligoester mit Hydroxylendgruppen.

Beispiele für aliphatische und cycloaliphatische Polyole sind Alkylendiole mit bevorzugt 2 bis 12 C-Atomen, wie Ethylengiykol, 1,2- oder 1,3-Propandiol, 1,2-, 1,3 oder 1,4-Butandiol, Pentandiol, Hexandiol, Octandiol, Dodecandiol, Diethylengiykol, Triethylengiykol, Polyethylengiykole mit Molekulargewichten von bevorzugt 200 bis 1500, 1,3-Cyclopentandiol, 1,2-, 1,3- oder 1,4-Cyclohexandiol, 1,4-Dihydroxymethylcyclohexan, Glycerin, Tris-(β-hydroxyethyl)amin, Trimethylolethan, Trimethylolpropan, Pentaerythrit, Dipentaerythrit und Sorbit.

Die Polyole können teilweise oder vollständig mit einer oder verschledenen ungesättigten Carbonsäuren verestert sein, wobei in Tellestern die freien Hydroxylgruppen modifiziert, z.B. veräthert oder mit anderen Carbonsäuren verestert sein können.

Beispiele für Ester sind:

Trimethylolpropantriacrylat, Trimethylolethantriacrylat, Trimethylolpropantrimethacrylat, Trimethylolethantrimethacrylat, Tetramethylengiykoldimethacrylat, Triethylengiykoldimethacrylat, Tetraethylengiykoldiacrylat, Pentaerythrittriacrylat, Pentaerythrittriacrylat, Dipentaerythrittriacrylat, Dipentaerythrittriacrylat, Dipentaerythrittriacrylat, Dipentaerythrittriacrylat, Dipentaerythrittoctaacrylat, Pentaerythrittrimethacrylat, Dipentaerythrittdimethacrylat, Dipentaerythrittrimethacrylat, Dipentaerythrittrimethacrylat, Dipentaerythrittrimethacrylat, Dipentaerythrittrimethacrylat, Pentaerythrittrimethacrylat, Dipentaerythrittrimethacrylat, Pentaerythrittrimethacrylat, Dipentaerythrittrimethacrylat, Dipent

Als Komponente (a) sind auch die Amide gleicher oder verschiedener ungesättigter Carbonsäuren von aromatischen, cycloaliphatischen und afiphatischen Polyaminen mit bevorzugt 2 bis 6, besonders 2 bls 4 Aminogruppen geelgnet. Beispleie für solche Polyamine sind Ethylendiamin, 1,2- oder 1,3-Propylendiamin, 1,2-, 1,3-oder 1,4-Butylendiamin, 1,5-Pentylendiamin, 1,6-Hexylendiamin, Octylendiamin, Dodecylendiamin, 1,4-Diaminocyclohexan, Isophorondiamin, Phenylendiamin, Bisphenylendiamin, Di- β -aminoethylether, Diethylentriamin, Triethylentetramin, Di- β -aminoethylether, Diethylentriamin, Triethylentetramin, Di- β -aminoethylether, Diethylendiamine sind Polymere und Copolymere mit Aminogruppen in der Seitenkette und Oligoamide mit Aminoendgruppen.

Beispiele für solche ungesättigten Amide sind: Methylen-bis-acrylamid, 1,6-Hexamethylen-bis-acrylamid, Diethylentriamin-tris-methacrylamid, Bis(methacrylamidopropoxy)-ethan, β-Methacrylamidoethylmethacrylat, N[(β-Hydroxyethoxy)ethyl]-acrylamid.

Geeignete ungesättigte Polyester und Polyamide leiten sich z.B. von Maleinsäure und Diolen oder Diaminen ab. Die Maleinsäure kann teilweise durch andere Dicarbonsäuren ersetzt sein. Sie können zusammen mit ethylenisch ungesättigten Comonomeren, z.B. Styrol, eingesetzt werden. Die Polyester und Polyamide können sich auch von Dicarbonsäuren und ethylenisch ungesättigten Diolen oder Diaminen ableiten, besonders von längerkettigen mit z.B. 6 bis 20 C-Atomen. Beispiele für Polyurethane sind solche, die aus gesättigten oder ungesättigten Diisocyanaten und ungesättigten bzw. gesättigten Diolen aufgebaut sind.

Polybutadlen und Polyisopren und Copolymere davon sind bekannt. Geeignete Comonomere sind z.B. Polyolefine wie Ethylen, Propen, Buten, Hexen, (Meth)Acrylate, Acrylnitril, Styrol oder Vinylchorid. Polymere mit (Meth)Acrylatgruppen in der Seitenkette sind ebenfalls bekannt. Es kann sich z.B. um Umsetzungsprodukte von Epoxidharzen auf Novolakbasis mit (Meth)Acrylsäure handeln, um Homo- oder Copolymere des Polyvinylalkohols oder deren Hydroxyalkylderivaten, die mit (Meth)Acrylsäure verestert sind, oder um Homo- und Copolymere von (Meth)Acrylaten, die mit Hydroxyalkyl(meth)acrylaten verestert sind.

Die photopolymerisierbaren Verbindungen können alieine oder in beliebigen Mischungen eingesetzt werden. Bevorzugt werden Gemische von Polyol-(Meth)Acrylaten verwendet.

Den erfindungsgemässen Zusammensetzungen können auch Bindemittel zugesetzt werden, was besonders zweckmässig ist, wenn es sich bei den photopolymerisierbaren Verbindungen um flüssige oder viskose Substanzen handelt. Die Menge des Bindemittels kann z.B. 5-95, vorzugsweise 10-90 und besonders 50-90 Gew.% betragen, bezogen auf die gesamte Zusammensetzung. Die Wahl des Bindemittels erfolgt je nach dem Anwendungsgebiet und hierfür geforderter Elgenschaften wie Entwickelbarkeit in wässrigen und organischen Lösungsmittelsystemen, Adhäsion auf Substraten und Sauerstoffempfindlichkeit.

Geeignete Bindemittel sind z.B. Polymere mit einem Molekulargewicht von etwa 5000-2 000 000, bevorzugt 10 000 bis 1 000 000. Beispiele sind: Homo- und copolymere Acrylate und Methacrylate; z.B. Copolymere aus Methylmethacrylat/Ethylacrylat/Methacrylsäure, Poly(methacrylsäurealkylester), Poly(acrylsäurealkylester); Celluloseester und -ether wie Celluloseeacetat, Celluloseacetatbutyrat, Methylcellulose, Ethylcellulose; Polyvinylbutyral, Polyvinylformal, cyclisierter Kautschuk, Polyether wie Polyethylenoxid, Polypropylenoxid, Polytetrahydrofuran; Polystyrol, Polycarbonat, Polyurethan, chlorierte Polyolefine, Polyvinylchlorid, Copolymere aus Vinylchlorid/Vinylidenchlorid, Copolymere von Vinylidenchlorid mit Acrylnitrii, Methylmethacrylat und Vinylacetat, Polyvinylacetat, Copoly(ethylen/vinylacetat), Polyamide wie Polycaprolactam und Poly(hexamethylenadipamid), Polyester wie Poly(āthylenglykolterephthalat) und Poly(hexamethylenglykolsuccinat).

Die erfindungsgemässen Zusammensetzungen eignen sich als Beschichtungsmittel für Substrate aller Art, z.B. Holz, Papier, Keramik, Kunststoffe, wie Polyester und Celluloseacetatfilme, und Metalle, wie Kupfer und Aluminium, bei denen durch Photopolymerisation eine Schutzschicht oder eine photographische Abbildung aufgebracht werden soll. Ein weiterer Gegenstand vorliegender Erfindung sind die beschichteten Substrate und ein Verfahren zum Aufbringen photographischer Abbildungen auf den Substraten.

Die Beschichtung der Substrate kann erfolgen, indem man eine flüssige Zusammensetzung, eine Lösung oder Suspension auf das Substrat aufbringt. Flüssige Zusammensetzungen ohne Lösungsmittel sind bevorzugt. Hierbel kann es zweckmässig sein, die erfindungsgemässen Titanocene in Form eines flüssigen Photoinitiatorengemisches, enthaltend andere Photoinitiatoren, z.B. ein Benzilketal, ein 4-Aroyl-1,3-dioxolan, ein Dialkoxyacetophenon, ein α-Hydroxy-oder α-Aminoacetophenon oder Mischungen hiervon einzusetzen. Besonders vorteilhaft sind flüssige Mischungen aus flüssigen bis festen Photoinitiatoren und flüssigen Titanocenen oder flüssigen Photoinitiatoren und sirupösen bis festen Titanocenen. Diese Gemische bieten anwendungstechnische Vorteile und zeichnen sich durch eine hohe Dunkellagerstabilität aus.

45

55

RO

Beispiele für Benzilketale sind solche der Formel

•=• OR¹⁴ •=• OR¹⁴

-(CH₂)₃CH₃ -CH₂CH₂CH(CH₃)₂ -CH₂- CH-C ₄H₉

-CH₂- CH-C C₂H₅ -{CH₂)₉CH₈

-C₁₀H₂₁-iso -C₁₂H₂₅-n

-C₉H₁₉bis -C₁₁H₂₃-Gemisch -C₁₂-H₂₅-bis-C₁₅H₃₁-Gemisch

-CH₂CH = CH₂ -CH(CH₃)CH = CH₂

-CH₂CH₂OC₃H₇-iso

-CH₂CH₂OC₄H₉

-CH2CH2OCH2CH == CH2

- -CH(CH₃)-CH₂OC₄H₉ -CH2COOCH3 -CH2COOC4H9 -CH(CH₃)COOCH₃ -CH2CH2COOC2H5 -CH(CH₃)CH₂COOCH₃ -CH2CH2CH(CH3)OCH3
- 10
- -(CH₂CH₂O)₂CH₃ 15 -(CH2CH2O)2C2H5 -(CH2CH2O)2C4H9 -(CH2CH2O)3CH3 -(CH2CH2O)3C2H5 -(CH2CH2O)3C12H26 20
- -(CH2CH2O)5C10H21 -(CH₂CH₂O)₈C₉H₁₉-bis-C₁₁H₂₃ (Gemisch)

$$-CH_2CH_2N(C_2H_5)_2$$

40

 $R^{14} = CH_3, R^{13} = C_6H_{13}$

 $R^{14} = CH_3, R^{13} = C_{10}H_{21}$

 $R^{14} = CH_3$, $R^{13} = \frac{1}{3}$ $CH_2CH_2O)_3 - C_{12}H_{26}$ bis- $C_{15}H_{31}$ (Gemisch) $R^{14} = CH_3$, $R^{13} = \frac{1}{3}$ $CH_2CH_2O)_5 - C_9H_{19}$ bis $-C_{11}H_{23}$ (Gemisch)

R14 = CH3, R13 =

(CH2CH2O)e-C-C11H23.

Beispiele für 4-Aroyl-1,3-dioxolane sind:

- 4-Benzoyl-2,2,4-trimethyl-1,3-dioxolan
 - 4-Benzoyl-4-methyl-2,2-tetramethylen-1,3-dioxolan
 - 4-Benzoyl-4-methyl-2,2-pentamethylen-1,3-dioxolan
 - cis-trans 4-Benzoyl-2,4-dimethyl-2-methoxymethyl-1,3-dioxolan
 - cis-trans 4-Benzoyl-4-methyl-2-phenyl-1,3-dloxolan
- 4-(4-Methoxybenzoyl)-2,2,4-trimethyl-1,3-dioxolan
 - 4-(4-Methoxybenzoyl)-4-methyl-2,2-pentamethylen-1,3-dioxolan
 - 4-(4-Methylbenzoyl)-2,2,4-trimethyl-1,3-dioxolan cis-trans 4-Benzyol-2-methyl-4-phenyl-1,3-dioxolan
 - 4-Benzoyl-2,2,4,5,5-pentamethyl-1,3-dioxolan
- cis-trans 4-Benzoyl-2,2,4,5-tetramethyl-1,3-dioxolan
 - cis-trans 4-Benzoyl-4-methyl-2-pentyl-1,3-dioxolan
 - cis-trans 4-Benzoyl-2-benzyl-2,4-dimethyl-1,3-dioxolan
 - cis-trans 4-Benzoyl-2-(2-furyl)-4-methyl-1,3-dioxolan
 - cis-trans 4-Benzoyl-5-phenyl-2,2,4-trimethyl-1,3-dioxolan
- 4-(4-Methoxybenzoyl)-2,2,4,5,5-pentamethyl-1,3-dioxolan.

0 255 486

•		
Beispiele für Dialkoxyacetophenone sind:		
α,α-Dimethoxyacetophenoi:		
α,α-Diethoxyacetophenon	:	
α,α-DI-Isopropoxyacetophenon		
α.α-DI-(2-methoxyethoxy)acetophenon		
α-Butoxy-α-ethoxyacetophenon		5
α.α-Dibutoxy-4-chloracetophenon	,	
α,α-Diethoxy-4-fluoracetophenon	1	
α,α-Dimethoxy-4-methylacetophenon		
α,α-Dimethoxy-4-methylacetophenon		
α,α-Dimethoxyproplophenon		10
a,a-Diethoxyproplophenon		
a,a-Diethoxybutyrophenon		
α,α-Dimethoxylsovalerophenon		
a,a-Diethoxy-a-cyclohexylacetophenon		15
α,α-Dipropoxy-4-chlorpropiophenon.	•	
Beispiele für a-Hydroxy- und a-Aminoacetophenone sind:		
2-Hydroxy-2-methyl-1-phenyl-propanon-1		
2-Hydroxy-2-ethyl-1-phenylhexanon-1		,
1-(4-Dodecylphenyl)-2-hydroxy-2-methylpropanon-1		20
1-{2,4-Dimethylphenyl}-2-hydroxy-2-methylpropanon-1		
2-Hydroxy-1-(4-methoxyphenyl)-2-methylpropanon-1		
2-Hydroxy-2-methyl-1-phenylbutanon-1		
2-Dimethylamino-2-methyl-1-phenylpropanon-1		
2-Dibutylamino-2-methyl-1-phenylpropanon-1		25
1-(4-Fluorphenyl)-2-methyl-2-morpholinopentanon-1		
2-Methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morphollnobutanon-1 2-Dimethylamino-1-(4-methoxyphenyl)-2-methylpropanon-1		
2-Distarylamino-1-(4-diethoxyphenyl)-2-methylpropanon-1.		
Des Photoinitistorengemisch (h) 1 (a) konn in Mongon von 0.5.00 vonversete 4 bt. 40.0 von		
Das Photoinitiatorengemisch (b) + (c) kann in Mengen von 0,5-20, vorzugsweise 1 bis 10 Gew0	/o,	30
zugegeben werden, bezogen auf die Komponente (a).	•	30
zugegeben werden, bezogen auf die Komponente (a). Die Wahl des Lösungsmittels und die Konzentration richtet sich hauptsächlich nach der Art d	ler	30
zugegeben werden, bezogen auf die Komponente (a). Die Wahl des Lösungsmittels und die Konzentration richtet sich hauptsächlich nach der Art die Zusammensetzung und nach dem Beschlichtungsverfahren. Die Zusammensetzung wird mittels bekennt	ler	30
zugegeben werden, bezogen auf die Komponente (a). Die Wahl des Lösungsmittels und die Konzentration richtet sich hauptsächlich nach der Art die Zusammensetzung und nach dem Beschichtungsverfahren. Die Zusammensetzung wird mittels bekannt Beschichtungsverfahren auf ein Substrat gleichförmig aufgebracht, z.B. durch Tauchen, Rakeibeschichtung	ler ter	
zugegeben werden, bezogen auf die Komponente (a). Die Wahl des Lösungsmittels und die Konzentration richtet sich hauptsächlich nach der Art die Zusammensetzung und nach dem Beschichtungsverfahren. Die Zusammensetzung wird mittels bekannt Beschichtungsverfahren auf ein Substrat gleichtörmig aufgebracht, z.B. durch Tauchen, Rakeibeschichtung Vorhanggiessverfahren, Elektrophorese, Aufpinseln, Sprayen oder Reverseroll-Beschichtung. Die Auftrad	ler ter ig.	<i>30</i>
zugegeben werden, bezogen auf die Komponente (a). Die Wahl des Lösungsmittels und die Konzentration richtet sich hauptsächlich nach der Art die Zusammensetzung und nach dem Beschichtungsverfahren. Die Zusammensetzung wird mittels bekannt Beschichtungsverfahren auf ein Substrat gleichtörmig aufgebracht, z.B. durch Tauchen, Rakeibeschichtun Vorhanggiessverfahren, Elektrophorese, Aufpinseln, Sprayen oder Reverseroll-Beschichtung. Die Auftrag menge (Schichtdicke) und Art des Substrates (Schichtträger) sind abhängig vom gewünschten Applikation	ler er ig.	
zugegeben werden, bezogen auf die Komponente (a). Die Wahl des Lösungsmittels und die Konzentration richtet sich hauptsächlich nach der Art die Zusammensetzung und nach dem Beschichtungsverfahren. Die Zusammensetzung wird mittels bekannt Beschichtungsverfahren auf ein Substrat gleichförmig aufgebracht, z.B. durch Tauchen, Rakeibeschichtun Vorhanggiessverfahren, Elektrophorese, Aufpinseln, Sprayen oder Reverseroll-Beschichtung. Die Auftrag menge (Schichtdicke) und Art des Substrates (Schichtträger) sind abhängig vom gewünschten Applikation gebiet. Als Schichtträger photographische Informationsaufzelchnung dienen z.B. Follen aus Polyeste	ler er g. g.	
zugegeben werden, bezogen auf die Komponente (a). Die Wahl des Lösungsmittels und die Konzentration richtet sich hauptsächlich nach der Art die Zusammensetzung und nach dem Beschichtungsverfahren. Die Zusammensetzung wird mittels bekannt Beschichtungsverfahren auf ein Substrat gleichtörmig aufgebracht, z.B. durch Tauchen, Rakeibeschichtun Vorhanggiessverfahren, Elektrophorese, Aufpinseln, Sprayen oder Reverseroll-Beschichtung. Die Auftrag menge (Schichtdicke) und Art des Substrates (Schichtträger) sind abhängig vom gewünschten Applikation gebiet. Als Schichtträger photographische Informationsaufzelchnung dienen z.B. Follen aus Polyest Celluloseacetat oder mit Kunststoff beschichtete Papiere; für Offsetdruckformen speziell behandelt	ler er er, es,	
zugegeben werden, bezogen auf die Komponente (a). Die Wahl des Lösungsmittels und die Konzentration richtet sich hauptsächlich nach der Art die Zusammensetzung und nach dem Beschichtungsverfahren. Die Zusammensetzung wird mittels bekannt Beschichtungsverfahren auf ein Substrat gleichtörnig aufgebracht, z.B. durch Tauchen, Räkelbeschichtun Vorhanggiessverfahren, Elektrophorese, Aufpinseln, Sprayen oder Reverseroll-Beschichtung. Die Auftrag menge (Schichtdicke) und Art des Substrates (Schichtträger) sind abhängig vom gewünschten Applikation gebiet. Als Schichtträger photographische informationsaufzelchnung dienen z.B. Follen aus Polyeste Celluloseacetat oder mit Kunststoff beschichtete Papiere; für Offsetdruckformen speziell behandelt Aluminium und für die Herstellung gedruckter Schaltungen kupferkaschierte Laminate. Die Schichtdicken t	ler ler lg. ls- ls- er, es	35
zugegeben werden, bezogen auf die Komponente (a). Die Wahl des Lösungsmittels und die Konzentration richtet sich hauptsächlich nach der Art die Zusammensetzung und nach dem Beschichtungsverfahren. Die Zusammensetzung wird mittels bekannt Beschichtungsverfahren auf ein Substrat gleichförmig aufgebracht, z.B. durch Tauchen, Rakeibeschichtun Vorhanggiessverfahren, Elektrophorese, Aufpinseln, Sprayen oder Reverseroll-Beschichtung. Die Auftrag menge (Schichtdicke) und Art des Substrates (Schichtträger) sind abhängig vom gewünschten Applikation gebiet. Als Schichtträger photographische informationsaufzelchnung dienen z.B. Follen aus Polyeste Celluloseacetat oder mit Kunststoff beschichtete Papiere; für Offsetdruckformen speziell behandelt Aluminium und für die Herstellung gedruckter Schaltungen kupferkaschierte Laminate. Die Schichtdicken in photographische Materialien und Offsetdruckformen betragen im allgemeinen ca. 0,5 bis ca. 10 um: 1	ler er ig, is- is- er, es für	
zugegeben werden, bezogen auf die Komponente (a). Die Wahl des Lösungsmittels und die Konzentration richtet sich hauptsächlich nach der Art die Zusammensetzung und nach dem Beschichtungsverfahren. Die Zusammensetzung wird mittels bekannt Beschichtungsverfahren auf ein Substrat gleichlörnig aufgebracht, z.B. durch Tauchen, Rakeibeschichtun Vorhanggiessverfahren, Elektrophorese, Aufpinseln, Sprayen oder Reverseroll-Beschichtung. Die Auftrag menge (Schichtdicke) und Art des Substrates (Schichtträger) sind abhängig vom gewünschten Applikation gebiet. Als Schichtträger photographische Informationsaufzelchnung dienen z.B. Follen aus Polyeste Celluloseacetat oder mit Kunststoff beschichtete Papiere; für Offsetdruckformen speziell behandelt Aluminium und für die Herstellung gedruckter Schaltungen kupferkaschierte Laminate. Die Schichtdicken in photographische Materialien und Offsetdruckformen betragen im allgemeinen ca. 0,5 bis ca. 10 μm; 1 gedruckte Schaltungen im allgemeinen 1 bis ca. 100 μm. Bei Mitverwendung von Lösungsmitteln werden die	ler er ig, is- is- er, es für	35
zugegeben werden, bezogen auf die Komponente (a). Die Wahl des Lösungsmittels und die Konzentration richtet sich hauptsächlich nach der Art die Zusammensetzung und nach dem Beschichtungsverfahren. Die Zusammensetzung wird mittels bekannt Beschichtungsverfahren auf ein Substrat gleichförmig aufgebracht, z.B. durch Tauchen, Rakeibeschichtun Vorhanggiessverfahren, Elektrophorese, Aufpinseln, Sprayen oder Reverseroll-Beschichtung. Die Auftrag menge (Schichtdicke) und Art des Substrates (Schichtträger) sind abhängig vom gewünschten Applikation gebiet. Als Schichtträger photographische Informationsaufzelchnung dienen z.B. Follen aus Polyeste Celluloseacetat oder mit Kunststoff beschichtete Papiere; für Offsetdruckformen speziell behandelt Aluminium und für die Herstellung gedruckter Schaltungen kupferkaschierte Laminate. Die Schichtdicken t photographische Materialien und Offsetdruckformen betragen im allgemeinen a. 0,5 bis ca. 10 μm; 1 gedruckte Schaltungen im allgemeinen 1 bis ca. 100 μm. Bei Mitverwendung von Lösungsmitteln werden die nach dem Beschichten entfernt.	ler er er, es für für se	35
zugegeben werden, bezogen auf die Komponente (a). Die Wahl des Lösungsmittels und die Konzentration richtet sich hauptsächlich nach der Art die Zusammensetzung und nach dem Beschichtungsverfahren. Die Zusammensetzung wird mittels bekannt Beschichtungsverfahren auf ein Substrat gleichförmig aufgebracht, z.B. durch Tauchen, Räkelbeschichtun Vorhanggiessverfahren, Elektrophorese, Aufpinseln, Sprayen oder Reverseroll-Beschichtung. Die Auftrag menge (Schichtdicke) und Art des Substrates (Schichtträger) sind abhängig vom gewünschten Applikation gebiet. Als Schichtträger photographische Informationsaufzelchnung dienen z.B. Follen aus Polyeste Celluloseacetat oder mit Kunststoff beschichtete Papiere; für Offsetdruckformen speziell behandelt Aluminium und für die Herstellung gedruckter Schaltungen kupferkaschierte Laminate. Die Schichtdicken t photographische Materialien und Offsetdruckformen betragen im allgemeinen a. 0,5 bis ca. 10 μm; 1 gedruckte Schaltungen im allgemeinen 1 bis ca. 100 μm. Bei Mitverwendung von Lösungsmitteln werden die nach dem Beschichten entfernt.	ler er ig. is- er, es für für se	35
zugegeben werden, bezogen auf die Komponente (a). Die Wahl des Lösungsmittels und die Konzentration richtet sich hauptsächlich nach der Art die Zusammensetzung und nach dem Beschichtungsverfahren. Die Zusammensetzung wird mittels bekannt Beschichtungsverfahren auf ein Substrat gleichförmig aufgebracht, z.B. durch Tauchen, Räkelbeschichtung Vorhanggiessverfahren, Elektrophorese, Aufpinseln, Sprayen oder Reverseroll-Beschichtung. Die Auftrag menge (Schichtdicke) und Art des Substrates (Schichtträger) sind abhängig vom gewünschten Applikation gebiet. Als Schichtträger photographische Informationsaufzelchnung dienen z.B. Follen aus Polyeste Celluloseacetat oder mit Kunststoff beschichtete Papiere; für Offsetdruckformen speziell behandelt Aluminium und für die Herstellung gedruckter Schaltungen kupferkaschierte Laminate. Die Schichtelcken thotographische Materialien und Offsetdruckformen betragen im allgemeinen ca. 0,5 bis ca. 10 μm; 1 gedruckte Schaltungen im allgemeinen 1 bis ca. 100 μm. Bei Mitverwendung von Lösungsmitteln werden die nach dem Beschichten entfernt. Photohärtbare Zusammensetzungen, wie sie für die verschiedenen Zwecke verwendet werden, enthalt meist ausser den photopolymerisierbaren Verbindungen und den Photoinitiätoren eine Reihe sonstie	ler ler lg. ls- ls- er, es für für se	35 40
zugegeben werden, bezogen auf die Komponente (a). Die Wahl des Lösungsmittels und die Konzentration richtet sich hauptsächlich nach der Art die Zusammensetzung und nach dem Beschichtungsverfahren. Die Zusammensetzung wird mittels bekannt Beschichtungsverfahren auf ein Substrat gleichförmig aufgebracht, z.B. durch Tauchen, Räkelbeschichtung Vorhanggiessverfahren, Elektrophorese, Aufpinseln, Sprayen oder Reverseroll-Beschichtung. Die Auftrag menge (Schichtdicke) und Art des Substrates (Schichtträger) sind abhängig vom gewünschten Applikation gebiet. Als Schichtträger photographische Informationsaufzelchnung dienen z.B. Follen aus Polyeste Celliuloseacetat oder mit Kunststoff beschichtete Papiere; für Offsetdruckformen speziell behandelt Aluminium und für die Herstellung gedruckter Schaltungen kupferkaschierte Laminate. Die Schichteldicken in photographische Materialien und Offsetdruckformen betragen im allgemeinen a. 0,5 bis ca. 10 μm; 1 gedruckte Schaltungen im allgemeinen 1 bis ca. 100 μm. Bei Mitverwendung von Lösungsmitteln werden die nach dem Beschichten entfernt. Photohärtbare Zusammensetzungen, wie sie für die verschiedenen Zwecke verwendet werden, enthalt meist ausser den photopolymerisierbaren Verbindungen und den Photoinitiatoren eine Reihe sonstig Zusätze. So ist es vielfach üblich, thermische Inhibitoren zuzusetzen, die vor allem während der Herstellungen zu zuzusetzen, die vor allem während der Herstellungen zu zuzusetzen, die vor allem während der Herstellungen zu	ler ler lg. ls- ls- er, es für für se	35
zugegeben werden, bezogen auf die Komponente (a). Die Wahl des Lösungsmittels und die Konzentration richtet sich hauptsächlich nach der Art die Zusammensetzung und nach dem Beschichtungsverfahren. Die Zusammensetzung wird mittels bekannt Beschichtungsverfahren auf ein Substrat gleichlörmig aufgebracht, z.B. durch Tauchen, Räkelbeschichtung Vorhanggiessverfahren, Elektrophorese, Aufpinseln, Sprayen oder Reverseroll-Beschichtung. Die Auftrag menge (Schichtdicke) und Art des Substrates (Schichtträger) sind abhängig vom gewünschten Applikation gebiet. Als Schichtträger photographische Informationsaufzelchnung dienen z.B. Follen aus Polyeste Celluloseacetat oder mit Kunststoff beschichtete Papiere; für Offsetdruckformen speziell behandelt Aluminium und für die Herstellung gedruckter Schaltungen kupferkaschierte Laminate. Die Schichtohtlicken in photographische Materialien und Offsetdruckformen betragen im allgemeinen a. 0,5 bis ca. 10 μm; 1 gedruckte Schaltungen im allgemeinen 1 bis ca. 100 μm. Bei Mitverwendung von Lösungsmitteln werden die nach dem Beschichten entfernt. Photohärtbare Zusammensetzungen, wie sie für die verschiedenen Zwecke verwendet werden, enthalt meist ausser den photopolymerisierbaren Verbindungen und den Photoinitiatoren eine Reihe sonstig Zusätze. So ist es vielfach üblich, thermische inhibitoren zuzusetzen, die vor allem während der Herstellu der Zusammensetzungen durch Mischen der Komponenten vor einer vorzeitigen Polymerisation schütz	ler ler ler les ler, les für se en ler ng	35 40
zugegeben werden, bezogen auf die Komponente (a). Die Wahl des Lösungsmittels und die Konzentration richtet sich hauptsächlich nach der Art die Zusammensetzung und nach dem Beschichtungsverfahren. Die Zusammensetzung wird mittels bekannt Beschichtungsverfahren auf ein Substrat gleichlörmig aufgebracht, z.B. durch Tauchen, Räkelbeschichtung Vorhanggiessverfahren, Elektrophorese, Aufpinseln, Sprayen oder Reverseroll-Beschichtung. Die Auftrag menge (Schichtdicke) und Art des Substrates (Schichtträger) sind abhängig vom gewünschten Applikation gebiet. Als Schichtträger photographische Informationsaufzelchnung dienen z.B. Follen aus Polyeste Celluloseacetat oder mit Kunststoff beschichtete Papiere; für Offsetdruckformen speziell behandelt Aluminium und für die Herstellung gedruckter Schaltungen kupferkaschierte Laminate. Die Schichtdicken in photographische Materialien und Offsetdruckformen betragen im allgemeinen ca. 0,5 bis ca. 10 μm; in gedruckte Schaltungen im allgemeinen 1 bis ca. 100 μm. Bei Mitverwendung von Lösungsmitteln werden die nach dem Beschichten entfernt. Photohärtbare Zusammensetzungen, wie sie für die verschiedenen Zwecke verwendet werden, enthalt meist ausser den photopolymerisierbaren Verbindungen und den Photoinitiatoren eine Reihe sonstig Zusätze. So ist es vielfach üblich, thermische inhibitoren zuzusetzen, die vor allem während der Herstellungen Zusammensetzungen durch Mischen der Komponenten vor einer vorzeitigen Polymerisation schütz sollen. Hierzu werden beispielsweise Hydrochinon, Hydrochinonderivate, p-Methoxyphenol, B-Naphthole od	er er es er, es für für se en per en der	35 40
zugegeben werden, bezogen auf die Komponente (a). Die Wahl des Lösungsmittels und die Konzentration richtet sich hauptsächlich nach der Art die Zusammensetzung und nach dem Beschichtungsverfahren. Die Zusammensetzung wird mittels bekannt Beschichtungsverfahren auf ein Substrat gleichlörmig aufgebracht, z.B. durch Tauchen, Räkelbeschichtung Vorhanggiessverfahren, Elektrophorese, Aufpinseln, Sprayen oder Reverseroll-Beschichtung. Die Auftrag menge (Schichtdicke) und Art des Substrates (Schichtträger) sind abhängig vom gewünschten Applikation gebiet. Als Schichtträger photographische Informationsaufzelchnung dienen z.B. Follen aus Polyeste Celluloseacetat oder mit Kunststoff beschichtete Papiere; für Offsetdrückformen speziell behandelt Aluminium und für die Herstellung gedrückter Schaltungen kupferkaschlerte Laminate. Die Schichtdicken in photographische Materialien und Offsetdrückformen betragen im allgemeinen ca. 0,5 bis ca. 10 μm; in gedrückte Schaltungen im allgemeinen 1 bis ca. 100 μm. Bei Mitverwendung von Lösungsmitteln werden die nach dem Beschichten entfermt. Photohärtbare Zusammensetzungen, wie sie für die verschiedenen Zwecke verwendet werden, enthalt meist ausser den photopolymerisierbaren Verbindungen und den Photoinitiatoren eine Reihe sonstig Zusätze. So ist es vielfach üblich, thermische inhibitoren zuzusetzen, die vor allem während der Herstellungen Zusammensetzungen durch Mischen der Komponenten vor einer vorzeitigen Polymerisation schütz sollen. Hierzu werden beispielsweise Hydrochinon, Hydrochinonderivate, p-Methoxyphenol, β-Naphthole od sterisch gehinderte Phenole wie z.B. 2,6-Di(tert-butyl)-p-kresol verwendet. Weiter können geringe Meno	er eg. ss- er, es für en en en en en	35 40
zugegeben werden, bezogen auf die Komponente (a). Die Wahl des Lösungsmittels und die Konzentration richtet sich hauptsächlich nach der Art die Zusammensetzung und nach dem Beschichtungsverfahren. Die Zusammensetzung wird mittels bekannt Beschichtungsverfahren auf ein Substrat gleichtörmig aufgebracht, z.B. durch Tauchen, Räkelbeschichtun Vorhanggiessverfahren, Elektrophorese, Aufpinseln, Sprayen oder Reverseroll-Beschichtung. Die Auftrag menge (Schichtdicke) und Art des Substrates (Schichtträger) sind abhängig vom gewünschten Applikation gebiet. Als Schichtträger photographische Informationsaufzelchnung dienen z.B. Follen aus Polyeste Celluloseacetat oder mit Kunststoff beschichtete Papiere; für Offsetdruckformen speziell behandelt Aluminium und für die Herstellung gedruckter Schaltungen kupferkaschlerte Laminate. Die Schichtdicken in photographische Materialien und Offsetdruckformen betragen im allgemeinen ca. 0,5 bis ca. 10 μm; gedruckte Schaltungen im allgemeinen 1 bis ca. 100 μm. Bei Mitverwendung von Lösungsmitteln werden die nach dem Beschichten entfernt. Photohärtbare Zusammensetzungen, wie sie für die verschiedenen Zwecke verwendet werden, enthalt meist ausser den photopolymeriserbaren Verbindungen und den Photoinitiatoren ehre Reihe sonstig Zusätze. So ist es vielfach üblich, thermische inhibitoren zuzusetzen, die vor allem während der Herstelku der Zusammensetzungen durch Mischen der Komponenten vor einer vorzeitigen Polymerisation schütz sollen. Hierzu werden beispielsweise Hydrochinon, Hydrochinonderivate, p-Methoxyphenol, β-Naphthole od sterisch gehinderte Phenole wie z.B. 2,6-Di(tert-butyl)-p-kresol verwendet. Welter können geringe Meng von UV-Absorbern zugesetzt werden, wie z.B. solche vom Benztriazol-, Benzophenon- oder Oxalanilid-Tv	er eg. ss- er, es für en en en en en	35 40 45
zugegeben werden, bezogen auf die Komponente (a). Die Wahl des Lösungsmittels und die Konzentration richtet sich hauptsächlich nach der Art die Zusammensetzung und nach dem Beschichtungsverfahren. Die Zusammensetzung wird mittels bekannt Beschichtungsverfahren auf ein Substrat gleichtörmig aufgebracht, z.B. durch Tauchen, Räkelbeschichtun Vorhanggiessverfahren, Elektrophorese, Aufpinseln, Sprayen oder Reverseroll-Beschichtung. Die Auftrag menge (Schichtdicke) und Art des Substrates (Schichtträger) sind abhängig vom gewünschten Applikation gebiet. Als Schichtträger photographische Informationsaufzelchnung dienen z.B. Follen aus Polyeste Celluloseacetat oder mit Kunststoff beschichtete Papiere; für Offsetdruckformen speziell behandelt Aluminium und für die Herstellung gedruckter Schaltungen kupferkaschlerte Laminate. Die Schichtdicken in photographische Materialien und Offsetdruckformen betragen im allgemeinen ca. 0,5 bis ca. 10 μm; 1 gedruckte Schaltungen im allgemeinen 1 bis ca. 100 μm. Bei Mitverwendung von Lösungsmitteln werden die nach dem Beschichten entfernt. Photohärtbare Zusammensetzungen, wie sie für die verschiedenen Zwecke verwendet werden, enthalt meist ausser den photopolymeriseierbaren Verbindungen und den Photoinitiatoren eine Reihe sonstig Zusätze. So ist es vielfach üblich, thermische Inhibitoren zuzusetzen, die vor allem während der Herstellungen. Hierzu werden beispielsweise Hydrochlinon, Hydrochlinonderivate, p-Methoxyphenol, β-Naphthole oct sterisch gehinderte Phenole wie z.B. 2,6-Di(tert-butyl)-p-kresol verwendet. Weiter können geringe Meng von UV-Absorbern zugesetzt werden, wie z.B. solche vom Benztriazol-, Benzophenon- oder Oxalanilld-Ty Ebenso lassen sich Lichtschutzmittel vom Typus sterisch gehinderter Amine (HALS) zusetzen.	ler der der der der der der der der der d	35 40
zugegeben werden, bezogen auf die Komponente (a). Die Wahl des Lösungsmittels und die Konzentration richtet sich hauptsächlich nach der Art die Zusammensetzung und nach dem Beschichtungsverfahren. Die Zusammensetzung wird mittels bekannt Beschichtungsverfahren auf ein Substrat gleichtörnig aufgebracht, z.B. durch Tauchen, Rakelbeschichtun Vorhanggiessverfahren, Elektrophorese, Aufpinseln, Sprayen oder Reverseroll-Beschichtung. Die Auftrag menge (Schichtdicke) und Art des Substrates (Schichtträger) sind abhängig vom gewünschten Applikation gebiet. Als Schichtträger photographische Informationsaufzelchnung dienen z.B. Follen aus Polyeste Celluloseacetat oder mit Kunststoff beschichtete Papiere; für Offsetdruckformen speziell behandelt Aluminium und für die Herstellung gedruckter Schaltungen kupferkaschlerte Laminate. Die Schichtdicken in photographische Materialien und Offsetdruckformen betragen im allgemeinen ca. 0,5 bis ca. 10 μm; 1 gedruckte Schaltungen im allgemeinen 1 bis ca. 100 μm. Bei Mitverwendung von Lösungsmitteln werden die nach dem Beschichten entfernt. Photohärtbare Zusammensetzungen, wie sie für die verschiedenen Zwecke verwendet werden, enthalt meist ausser den photopolymerisierbaren Verbindungen und den Photoinitiatoren eine Reihe sonstig Zusätze. So ist es vielfach üblich, thermische Inhibitoren zuzusetzen, die vor allem während der Herstellu der Zusammensetzungen durch Mischen der Komponenten vor einer vorzeitigen Polymerisation schütz sollen. Hierzu werden beispielsweise Hydrochlinon, Hydrochlinonderivate, p-Methoxyphenol, β-Naphthole og sterisch gehinderte Phenole wie z.B. 2,6-Di(tert-butyl)-p-kresol verwendet. Welter können geringe Meng von UV-Absorbern zugesetzt werden, wie z.B. solche vom Benztriazol-, Benzophenon- oder Oxalanilld-Ty Ebenso lassen sich Lichtschutzmittel vom Typus sterisch gehinderter Amine (HALS) zusetzen. Zur Erhöhung der Dunkellagerstabilität können Kupferverbindungen, wie Kupfermaphthenat, -stearat, od	ler der der der der der der der der der	35 40 45
zugegeben werden, bezogen auf die Komponente (a). Die Wahl des Lösungsmittels und die Konzentration richtet sich hauptsächlich nach der Art die Zusammensetzung und nach dem Beschichtungsverfahren. Die Zusammensetzung wird mittels bekannt Beschichtungsverfahren auf ein Substrat gleichförmig aufgebracht, z.B. durch Tauchen, Rakeibeschichtun Vorhanggiessverfahren, Elektrophorese, Aufpinseln, Sprayen oder Reverseroll-Beschichtung. Die Auftrag menge (Schichtdicke) und Art des Substrates (Schichtträger) sind abhängig vom gewünschten Applikation gebiet. Als Schichtträger photographische Informationsaufzelchnung dienen z.B. Follen aus Polyeste Celluloseacetat oder mit Kunststoff beschichtete Papiere; für Offsetdruckformen speziell behandelt Aluminium und für die Herstellung gedruckter Schaltungen kupferkaschlerte Laminate. Die Schichtdicken in photographische Materialien und Offsetdruckformen betragen im allgemeinen a. 0,5 bis ca. 10 μm; 1 gedruckte Schaltungen im allgemeinen 1 bis ca. 100 μm. Bei Mitverwendung von Lösungsmitteln werden die nach dem Beschichten entfernt. Photohärtbare Zusammensetzungen, wie sie für die verschiedenen Zwecke verwendet werden, enthalt meist ausser den photopolymerisierbaren Verbindungen und den Photoinitiatoren eine Reihe sonstig Zusätze. So ist es vieiffach üblich, thermische inhibitoren zuzusetzen, die vor allem während der Herstellu der Zusammensetzungen durch Mischen der Komponenten vor einer vorzeitigen Polymerisation schütz sollen. Hierzu werden beispielsweise Hydrochlinon, Hydrochlinonderivate, p-Methoxyphenol, β-Naphthole od sterisch gehinderte Phenole wie z.B. 2,6-Di(tert-butyl)-p-kresol verwendet. Weiter können geringe Meng von UV-Absorbern zugesetzt werden, wie z.B. solche vom Benztriazol-, Benzophenon- oder Oxalanilld-Ty Ebenso lassen sich Lichtschutzmittel vom Typus sterisch gehinderter Amine (HALS) zusetzen. Zur Erhöhung der Dunkellagerstebilität können Kupferverbindungen, wie Kupfermaphthenat, -stearat, od-octoat, Phosphorverbindungen, wie Triphenylphosphin, Tributylpho	ler eg, is-is-is-is-is-is-is-is-is-is-is-is-is-i	35 40 45
zugegeben werden, bezogen auf die Komponente (a). Die Wahl des Lösungsmittels und die Konzentration richtet sich hauptsächlich nach der Art die Zusammensetzung und nach dem Beschichtungsverfahren. Die Zusammensetzung wird mittels bekannt Beschichtungsverfahren auf ein Substrat gleichförmig aufgebracht, z.B. durch Tauchen, flakeibeschichtun Vorhanggiessverfahren, Elektrophorese, Aufpinseln, Sprayen oder Reverseroll-Beschichtung. Die Auftrag menge (Schichtdicke) und Art des Substrates (Schichtträger) sind abhängig vom gewünschten Applikationt gebiet. Als Schichtträger photographische Informationsaufzelchnung dienen z.B. Follen aus Polyest Celluloseacetat oder mit Kunststoff beschichtete Papiere; für Offsetdruckformen spezielt behandelt Aluminium und für die Herstellung gedruckter Schaltungen kupferkaschlerte Laminate. Die Schichtdicken in photographische Materialien und Offsetdruckformen betragen im allgemeinen ca. 0,5 bis ca. 10 μm; nigedruckte Schaltungen im allgemeinen 1 bis ca. 100 μm. Bei Mitverwendung von Lösungsmitteln werden die nach dem Beschichten entfernt. Photohärtbare Zusammensetzungen, wie sie für die verschiedenen Zwecke verwendet werden, enthalt meist ausser den photopolymerisierbaren Verbindungen und den Photoinitiatoren eine Reihe sohstig Zusätze. So ist es vielfach üblich, thermische inhibitoren zuzusetzen, die vor allem während der Herstelltu der Zusammensetzungen durch Mischen der Komponenten vor einer vorzeitigen Polymerisation schütz sollen. Hierzu werden beispielsweise Hydrochlinon, Hydrochlinonderivate, p-Methoxyphenol, β-Naphthole od sterisch gehinderte Phenole wie z.B. 2,6-Di(tert-butyl)-p-kresol verwendet. Welter können geringe Meng von UV-Absorbern zugesetzt werden, wie z.B. solche vom Benztriazol-, Benzophenon- oder Oxalanilld-Ty Ebenso lassen sich Lichtschutzmittel vom Typus sterisch gehinderter Amine (HALS) zusetzen. Zur Erhöhung der Dunkellagerstabilität können Kupferverbindungen, wie Kupfermaphthenat, -stearat, oder Tribenzylphosphit, quaternäre Ammoniumverbindungen, wie Terp	ler eg, is- is- is- is- is- is- is- is- is- is-	35 40 45
zugegeben werden, bezogen auf die Komponente (a). Die Wahl des Lösungsmittels und die Konzentration richtet sich hauptsächlich nach der Art die Zusammensetzung und nach dem Beschichtungsverfahren. Die Zusammensetzung wird mittels bekannt Beschichtungsverfahren auf ein Substrat gleichförmig aufgebracht, z.B. durch Tauchen, Rakelbeschichtun Vorhanggiessverfahren, Elektrophorese, Aufpinseln, Sprayen oder Reverseroll-Beschichtung. Die Auftrag menge (Schichtdicke) und Art des Substrates (Schichtträger) sind abhängig vom gewünschten Applikation gebiet. Als Schichtträger photographische Informationsaufzelchnung dienen z.B. Follen aus Polyeste Celluloseacetat oder mit Kunststoff beschichtete Papiere; für Offsetdruckformen spezielt behandelt Aluminium und für die Herstellung gedruckter Schaltungen kupferkaschlerte Laminate. Die Schichtdicken in photographische Materiallen und Offsetdruckformen betragen im allgemeinen ca. 0,5 bls ca. 10 μm; 1 gedruckte Schaltungen im allgemeinen 1 bis ca. 100 μm. Bel Mitverwendung von Lösungsmitteln werden die nach dem Beschichten entfernt. Photohärtbare Zusammensetzungen, wie sie für die verschiedenen Zwecke verwendet werden, enthalt meist ausser den photopolymerisierbaren Verbindungen und den Photoinitiatoren eine Reihe sohstig Zusätze. So ist es vielfach üblich, thermische inhibitoren zuzusetzen, die vor allem wählend der Herstellu der Zusammensetzungen durch Mischen der Komponenten vor einer vorzeitigen Polymerisation schütz sollen. Hierzu werden beispielsweise Hydrochinon, Hydrochinonderivate, p-Methoxyphenol, β-Naphtholo osterisch gehinderte Phenole wie z.B. 2,6-Di(tert-butyl)-p-kresol verwendet. Welter können geringe Meng von UV-Absorbern zugesetzt werden, wie z.B. solche vom Benztriazol-, Benzophenon- oder Oxalanlild-Ty Ebenso lassen sich Lichtschutzmittel vom Typus sterisch gehinderter Amine (HALS) zusetzen. Zur Ernöhung der Dunkellagerstablilität können Kupferverbindungen, wie Kupfermaphthenat, -stearat, or octoat, Phosphorverbindungen, wie Triphenylphosphin, Tributylphosph	ler eer og se	35 40 45
zugegeben werden, bezogen auf die Komponente (a). Die Wahl des Lösungsmittels und die Konzentration richtet sich hauptsächlich nach der Art die Zusammensetzung und nach dem Beschlichtungsverfahren. Die Zusammensetzung wird mittels bekannt Beschlichtungsverfahren auf ein Substrat gleichförmig aufgebracht, z.B. durch Tauchen, Rakeibeschlichtun Vorhanggiessverfahren, Elektrophorese, Aufpinseln, Sprayen oder Reverseroil-Beschlichtung. Die Auftrag menge (Schichtdicke) und Art des Substrates (Schichtträger) sind abhängig vom gewünschten Applikation gebiet. Als Schichtträger photographische Informationsaufzelchnung dienen z.B. Follen aus Polyeste Celluloseacetat oder mit Kunststoff beschichtete Papiere; für Offsetdruckformen speziell behandelt Aluminium und für die Herstellung gedruckter Schaltungen kupferkaschlerte Laminate. Die Schichtdicken in photographische Materiallen und Offsetdruckformen betragen im allgemeinen ca. 0,5 bls ca. 10 μm; in gedruckte Schaltungen im allgemeinen 1 bis ca. 100 μm. Bei Mitverwendung von Lösungsmitteln werden die nach dem Beschichten entfernt. Photohärtbare Zusammensetzungen, wie sie für die verschiedenen Zwecke verwendet werden, enthalt meist ausser den photopolymerisierbaren Verbindungen und den Photoinitiatoren eine Reihe sohstig Zusätze. So ist es vielfach üblich, thermische inhibitoren zuzusetzen, die vor allem wählend der Herstellu der Zusammensetzungen durch Mischen der Komponenten vor einer vorzeitigen Polymerisation schütz sollen. Hierzu werden beispielsweise Hydrochlinon, Hydrochlinonderivate, prhethoxyphenol, β-Naphthole oc sterisch gehinderte Phenole wie z.B. 2,6-Di(tert-butyl)-p-kresol verwendet. Welter können geringe Meng von UV-Absorbern zugesetzt werden, wie z.B. solche vom Benztriazol-, Benzophenon- oder Oxalanilld-Ty Ebenso lassen sich Lichtschutzmittel vom Typus sterisch gehinderter Amine (HALS) zusetzen. Zur Erhöhung der Dunkellagerstabilität können Kupferverbindungen, wie Kupfermaphthenat, -stearat, ot octoat, Phosphorverbindungen, wie Triphenylphosphit, Triphe	ler eg. ser, estructe en	35 40 45
zugegeben werden, bezogen auf die Komponente (a). Die Wahl des Lösungsmittels und die Konzentration richtet sich hauptsächlich nach der Art die Zusammensetzung und nach dem Beschlichtungsverfahren. Die Zusammensetzung wird mittels bekannt Beschlichtungsverfahren auf ein Substrat gleichförmig aufgebracht, z.B. durch Tauchen, Rakeibeschlichtun Vorhanggiessverfahren, Elektrophorese, Aufpinseln, Sprayen oder Reverseroil-Beschlichtung. Die Auftrag menge (Schichtdicke) und Art des Substrates (Schichtträger) sind abhängig vom gewünschten Applikation gebiet. Als Schichtträger photographische Informationsaufzelchnung dienen z.B. Follen aus Polyeste Celluloseacetat oder mit Kunststoff beschichtete Papiere; für Offsetdruckformen speziell behandelt Aluminium und für die Herstellung gedruckter Schaltungen kupferkaschlerte Laminate. Die Schichtdicken in photographische Materiallen und Offsetdruckformen betragen im allgemeinen ca. 0,5 bls ca. 10 μm; in gedruckte Schaltungen im allgemeinen 1 bis ca. 100 μm. Bei Mitverwendung von Lösungsmitteln werden die nach dem Beschichten entfernt. Photohärtbare Zusammensetzungen, wie sie für die verschiedenen Zwecke verwendet werden, enthalt meist ausser den photopolymerisierbaren Verbindungen und den Photoinitiatoren eine Reihe sohstig Zusätze. So ist es vielfach üblich, thermische inhibitoren zuzusetzen, die vor allem wählend der Herstellu der Zusammensetzungen durch Mischen der Komponenten vor einer vorzeitigen Polymerisation schütz sollen. Hierzu werden beispielsweise Hydrochlinon, Hydrochlinonderivate, prhethoxyphenol, β-Naphthole oc sterisch gehinderte Phenole wie z.B. 2,6-Di(tert-butyl)-p-kresol verwendet. Welter können geringe Meng von UV-Absorbern zugesetzt werden, wie z.B. solche vom Benztriazol-, Benzophenon- oder Oxalanilld-Ty Ebenso lassen sich Lichtschutzmittel vom Typus sterisch gehinderter Amine (HALS) zusetzen. Zur Erhöhung der Dunkellagerstabilität können Kupferverbindungen, wie Kupfermaphthenat, -stearat, ot octoat, Phosphorverbindungen, wie Triphenylphosphit, Triphe	ler eg. ser, estructe en	35 40 45
zugegeben werden, bezogen auf die Komponente (a). Die Wahl des Lösungsmittels und die Konzentration richtet sich hauptsächlicht nach der Art dizusammensetzung und nach dem Beschichtungsverfahren. Die Zusammensetzung wird mittels bekannt Beschichtungsverfahren auf ein Substrat gleichiförmig aufgebracht, z.B. durch Tauchen, Räkelbeschichtung Vorhanggiessverfahren, Elektrophorese, Aufpinseln, Sprayen oder Reverseroll-Beschichtung. Die Auftrag menge (Schichtdlicke) und Art des Substrates (Schichtträger) sind abhängig vom gewünschten Applikation gebiet. Als Schichtträger photographische Informationsaufzelchnung dienen z.B. Follen aus Polyest Celluloseacetat oder mit Kunststoff beschichtete Paplere; für Offsetdruckformen speziell behandelt Aluminium und für die Herstellung gedruckter Schaltungen kupferkaschlerte Laminate. Die Schichtdlicken photographische Materiallen und Offsetdruckformen betragen im allgemeinen ca. 0,5 bls ca. 10 μm; ngedruckte Schaltungen im allgemeinen 1 bis ca. 100 μm. Bei Mitverwendung von Lösungsmitteln werden die nach dem Beschichten entfernt. Photohärtbere Zusammensetzungen, wie sie für die verschiedenen Zwecke verwendet werden, enthalt meist ausser den photopolymerisierbaren Verbindungen und den Photoinitiatoren eine Reihe schstig Zusätze. So ist es vielfach üblich, thermische Inhibitoren zuzusetzen, die vor allem während der Herstellu der Zusammensetzungen durch Mischen der Komponenten vor einer vorzeitigen Polymerisation schütz sollen. Hierzu werden beispielsweise Hydrochlinon, Hydrochinonderivate, p-Methoxyphenol, β-Naphthole oc sterisch gehinderte Phenole wie z.B. 2,6-Di(tert-butyl)-p-kresol verwendet. Welter können geringe Meng von UV-Absorbern zugesetzt werden, wie z.B. solche vom Benztriazol-, Benzophenon- oder Oxalanilid-Tiebenso lassen sich Lichtschutzmittel vom Typus sterisch gehinderter Amine (HALS) zusetzen. Zur Ernöhung der Dunkellagerstabilität können Kupferverbindungen, wie Kupfermaphthenat, -stearat, oc-octoat, Phosphorverbindungen, wie Terhamethylammoniumchlorid oder Tri	ler eg. seis-is-is-is-is-is-is-is-is-is-is-is-is-i	35 40 45
zugegeben werden, bezogen auf die Komponente (a). Die Wahl des Lösungsmittels und die Konzentration richtet sich hauptsächlicht nach der Art dizusammensetzung und nach dem Beschichtungsverfahren. Die Zusammensetzung wird mittels bekannt Beschichtungsverfahren auf ein Substrat gleichiförmig aufgebracht, z.B. durch Tauchen, Räkelbeschichtung Vorhanggiessverfahren, Elektrophorese, Aufpinseln, Sprayen oder Reverseroll-Beschichtung. Die Auftrag menge (Schichtdlicke) und Art des Substrates (Schichtträger) sind abhängig vom gewünschten Applikation gebiet. Als Schichtträger photographische Informationsaufzelchnung dienen z.B. Follen aus Polyest Celluloseacetat oder mit Kunststoff beschichtete Paplere; für Offsetdruckformen speziell behandelt Aluminium und für die Herstellung gedruckter Schaltungen kupferkaschlerte Laminate. Die Schichtdlicken photographische Materiallen und Offsetdruckformen betragen im allgemeinen ca. 0,5 bls ca. 10 μm; ngedruckte Schaltungen im allgemeinen 1 bis ca. 100 μm. Bei Mitverwendung von Lösungsmitteln werden die nach dem Beschichten entfernt. Photohärtbere Zusammensetzungen, wie sie für die verschiedenen Zwecke verwendet werden, enthalt meist ausser den photopolymerisierbaren Verbindungen und den Photoinitiatoren eine Reihe schstig Zusätze. So ist es vielfach üblich, thermische Inhibitoren zuzusetzen, die vor allem während der Herstellu der Zusammensetzungen durch Mischen der Komponenten vor einer vorzeitigen Polymerisation schütz sollen. Hierzu werden beispielsweise Hydrochlinon, Hydrochinonderivate, p-Methoxyphenol, β-Naphthole oc sterisch gehinderte Phenole wie z.B. 2,6-Di(tert-butyl)-p-kresol verwendet. Welter können geringe Meng von UV-Absorbern zugesetzt werden, wie z.B. solche vom Benztriazol-, Benzophenon- oder Oxalanilid-Tiebenso lassen sich Lichtschutzmittel vom Typus sterisch gehinderter Amine (HALS) zusetzen. Zur Ernöhung der Dunkellagerstabilität können Kupferverbindungen, wie Kupfermaphthenat, -stearat, oc-octoat, Phosphorverbindungen, wie Terhamethylammoniumchlorid oder Tri	ler eg. seis-is-is-is-is-is-is-is-is-is-is-is-is-i	35 40 45
zugegeben werden, bezogen auf die Komponente (a). Die Wahl des Lösungsmittels und die Konzentration richtet sich hauptsächlich nach der Art dizusammensetzung und nach dem Beschichtungsverfahren. Die Zusammensetzung wird mittels bekannt Beschichtungsverfahren auf ein Substrat gleichförmig aufgebracht, z.B. durch Tauchen, Räkelbeschichtun Vorhanggiessverfahren, Elektrophorese, Aufpinseln, Sprayen oder Reverseroll-Beschichtung. Die Auftrag menge (Schichtdicke) und Art des Substrates (Schichtträger) sind abhängig vom gewünschten Applikation gebiet. Als Schichtträger photographische Informationsautzelchnung dienen z.B. Follen aus Polyeste Celluloseacetat oder mit Kunststoff beschichtete Papiere; für Offsetdruckformen speziell behandelt Aluminium und für die Herstellung gedruckter Schaltungen kupferkaschierte Laminate. Die Schichtdicken in photographische Materialien und Offsetdruckformen betragen im allgemeinen ca. 0,5 bls ca. 10 μm; 1 gedruckte Schaltungen im allgemeinen 1 bis ca. 100 μm. Bel Mitverwendung von Lösungsmitteln werden die nach dem Beschichten entfernt. Photohärtbare Zusammensetzungen, wie sie für die verschiedenen Zwecke verwendet werden, enthalt meist ausser den photopolymerlsierbaren Verbindungen und den Photoinitiätoren eine Reihe sohstig Zusätze. So ist es vielfach üblich, thermische inhibitoren zuzusetzen, die vor allem wählend der Hersteltu der Zusammensetzungen durch Mischen der Komponenten vor einer vorzeitigen Polymerisation schütz sollen. Hierzu werden beispielsweise Hydrochlinon, Hydrochlinonderivate, p-Methoxyphenio, β-Naphthole oc sterisch gehinderte Phenole wie z.B. 2,6-Di(tert-butyl)-p-kresol verwendet. Welter können geringe Meng von UV-Absorbern zugesetzt werden, wie z.B. solche vom Benztriazol-, Benzophenon- oder Oxalanilid-Ti Ebenso lassen sich Lichtschutzmittel vom Typus sterisch gehinderter Amine (HALS) zusetzen. Zur Erhöhung der Dunkellagerstebilität können Kupferverbindungen, wie Kupfermaphthenat, -stearat, or -octoat, Phosphorverbindungen, wie Triphenylphosphin, Tributylphos	ler eg.s-is-is-is-is-is-is-is-is-is-is-is-is-is	35 40 45 50
zugegeben werden, bezogen auf die Komponente (a). Die Wahl des Lösungsmittels und die Konzentration richtet sich hauptsächlich nach der Art dizusammensetzung und nach dem Beschichtungsverfahren. Die Zusammensetzung wird mittels bekannt Beschichtungsverfahren auf ein Substrat gleichförmig aufgebracht, z.B. durch Tauchen, Räkelbeschichtun Vorhanggiessverfahren, Elektrophorese, Aufpinseln, Sprayen oder Reverseroll-Beschichtung. Die Auftrag menge (Schichtdicke) und Art des Substrates (Schichtträger) sind abhängig vom gewünschten Applikation gebiet. Als Schichtträger photographische Informationsautzelchnung dienen z.B. Follen aus Polyeste Celluloseacetat oder mit Kunststoff beschichtete Papiere; für Offsetdruckformen speziell behandelt Aluminium und für die Herstellung gedruckter Schaltungen kupferkaschierte Laminate. Die Schichtdicken in photographische Materialien und Offsetdruckformen betragen im allgemeinen ca. 0,5 bls ca. 10 μm; 1 gedruckte Schaltungen im allgemeinen 1 bis ca. 100 μm. Bel Mitverwendung von Lösungsmitteln werden die nach dem Beschichten entfernt. Photohärtbare Zusammensetzungen, wie sie für die verschiedenen Zwecke verwendet werden, enthalt meist ausser den photopolymerlsierbaren Verbindungen und den Photoinitiätoren eine Reihe sohstig Zusätze. So ist es vielfach üblich, thermische inhibitoren zuzusetzen, die vor allem wählend der Hersteltu der Zusammensetzungen durch Mischen der Komponenten vor einer vorzeitigen Polymerisation schütz sollen. Hierzu werden beispielsweise Hydrochlinon, Hydrochlinonderivate, p-Methoxyphenio, β-Naphthole oc sterisch gehinderte Phenole wie z.B. 2,6-Di(tert-butyl)-p-kresol verwendet. Welter können geringe Meng von UV-Absorbern zugesetzt werden, wie z.B. solche vom Benztriazol-, Benzophenon- oder Oxalanilid-Ti Ebenso lassen sich Lichtschutzmittel vom Typus sterisch gehinderter Amine (HALS) zusetzen. Zur Erhöhung der Dunkellagerstebilität können Kupferverbindungen, wie Kupfermaphthenat, -stearat, or -octoat, Phosphorverbindungen, wie Triphenylphosphin, Tributylphos	ler eg.s-is-is-is-is-is-is-is-is-is-is-is-is-is	35 40 45
zugegeben werden, bezogen auf die Komponente (a). Die Wahl des Lösungsmittels und die Konzentration richtet sich hauptsächlich nach der Art die Zusammensetzung und nach dem Beschichtungsverfahren. Die Zusammensetzung wird mittels bekannt Beschichtungsverfahren auf ein Substrat gleichförmig aufgebracht, z.B. durch Tauchen, Rakelbeschichtung Vorhanggiessverfahren, Elektrophorese, Aufpinseln, Sprayen oder Reverseroll-Beschichtung. Die Auftrag menge (Schichtdicke) und Art des Substrates (Schichtträger) sind abhängig vom gewönschten Applikation gebiet. Als Schichtträger photographische Informationsaufzelchnung dienen z.B. Follen aus Polyeste Celluloseacetat oder mit Kunststoff beschichtete Papiere; für Offsetdruckformen speziell behandelt Aluminium und für die Herstellung gedruckter Schaltungen kupferkaschierte Laminate. Die Schichtdicken in photographische Materialien und Offsetdruckformen betragen im allgemeinen ca. 0,5 bls ca. 10 μm; nigedruckte Schaltungen im allgemeinen 1 bis ca. 100 μm. Bel Mitverwendung von Lösungsmitteln werden die nach dem Beschichten entternt. Photohärtbare Zusammensetzungen, wie sie für die verschiedenen Zwecke verwendet werden, enthalt meist ausser den photopolymerisierbaren Verbindungen und den Photoinitiatoren eine Reihe sohstig Zusätze. So ist es vielfach üblich, thermische inhibitoren zuzusetzen, die vor allem während der Herstellu der Zusammensetzungen durch Mischen der Komponenten vor einer vorzeitigen Polymerisation schütz sollen. Hierzu werden beispielsweise Hydrochlinon, Hydrochlinonderivate, p-Methoxyphenol, β-Naphthole oc sterisch gehinderte Phenole wie z.B. 2,6-Di(tert-butyl)-p-kresol verwendet. Welter können geringe Meng von UV-Absorbern zugesetzt werden, wie z.B. solche vom Benztriazol-, Benzophenon- oder Oxalanilld-Ti. Ebenso lassen sich Lichtschutzmittel vom Typus sterisch gehinderter Amine (HALS) zusetzen. Zur Erhöhung der Dunkellagerstabilität können Kupferverbindungen, wie Kupfermaphthenat, -stearat, ot-octoat, Phosphorverbindungen, wie Triphenylphosphin, Tributylph	er eer egs-se-se er eer eer eer eer eer eer eer eer ee	35 40 45 50
zugegeben werden, bezogen auf die Komponente (a). Die Wahl des Lösungsmittels und die Konzentration richtet sich hauptsächlich nach der Art die Zusammensetzung und nach dem Beschichtungsverfahren. Die Zusammensetzung wird mittels bekannt Beschichtungsverfahren auf ein Substrat gleichförmig aufgebracht, z.B. durch Tauchen, Räkelbeschichtung Vorhanggiessverfahren, Elektrophorese, Aufpinseln, Sprayen oder Reverseroll-Beschichtung. Die Auftrag menge (Schichtdicke) und Art des Substrates (Schichtträger) sind abhängig vom gewünschten Applikation gebiet. Als Schichtträger photographische Informationsaufzeichnung dienen z.B. Follen aus Polyest Celluloseacetat oder mit Kunststoff beschichtete Papiere; für Offsetdruckformen speziell behandelt Aluminium und für die Herstellung gedruckter Schaltungen kupferkaschlerte Laminate. Die Schichtdicken 1 photographische Materialien und Offsetdruckformen betragen im allgemeinen α. 0,5 bis ca. 10 μm; 1 gedruckte Schaltungen im allgemeinen 1 bis ca. 100 μm. Bel Mitverwendung von Lösungsmitteln werden die nach dem Beschichten entremt. Photohärtbare Zusammensetzungen, wie sie für die verschiedenen Zwecke verwendet werden, enthalt meist ausser den photopolymerisierbaren Verbindungen und den Photoinitiatoren eine Reihe sohstig Zusätze. So ist es vielfach üblich, thermische Inhibitoren zuzusetzen, die vor allem während der Herstellu der Zusammensetzungen durch Mischen der Komponenten vor einer vorzeitigen Polymerisation schütz sollen. Hierzu werden beispielsweise Hydrochlinon, Hydrochlinonderivate, p-Methoxyphenol, β-Naphthole oc sterisch gehinderte Phenole wie z.B. 2,6-Dittert-butyl)-p-kresol verwendet. Weiter können geringe Meng von UV-Absorberm zugesetzt werden, wie z.B. solche vom Benztriazol-, Benzophenon- oder Oxalanilld-Ty Ebenso lassen sich Lichtschutzmittel vom Typus sterisch gehinderter Amine (HALS) zusetzen. Zur Ernöhung der Dunkellagerstebilität können Kupterverbindungen, wie Kuptermaphthenat, -stearat, ot octoat, Phosphorverbindungen, wie Triphenylphosphin, Tributylphosph	ler egserser eer gergeer eer de eer geserser gergeer eer gergeer eer gergeer eer gergeer eer	35 40 45 50
zugegeben werden, bezogen auf die Komponente (a). Die Wahl des Lösungsmittels und die Konzentration richtet sich hauptsächlich nach der Art die Zusammensetzung und nach dem Beschichtungsverfahren. Die Zusammensetzung wird mittels bekannt Beschichtungsverfahren auf ein Substrat gleichförmig aufgebracht, z.B. durch Tauchen, Räkelbeschichtung Vorhanggiessverfahren, Elektrophorese, Aufpinseln, Sprayen oder Reverseroll-Beschichtung. Die Auftrag menge (Schichtdicke) und Art des Substrates (Schichtträger) sind abhängig vom gewünschten Applikation gebiet. Als Schichtträger photographische Informationsaufzeichnung dienen z.B. Follen aus Polyest Celluloseacetat oder mit Kunststoff beschichtete Papiere; für Offsetdruckformen speziell behandelt Aluminium und für die Herstellung gedruckter Schaltungen kupferkaschlerte Laminate. Die Schichtdicken 1 photographische Materialien und Offsetdruckformen betragen im allgemeinen α. 0,5 bis ca. 10 μm; 1 gedruckte Schaltungen im allgemeinen 1 bis ca. 100 μm. Bel Mitverwendung von Lösungsmitteln werden die nach dem Beschichten entremt. Photohärtbare Zusammensetzungen, wie sie für die verschiedenen Zwecke verwendet werden, enthalt meist ausser den photopolymerisierbaren Verbindungen und den Photoinitiatoren eine Reihe sohstig Zusätze. So ist es vielfach üblich, thermische Inhibitoren zuzusetzen, die vor allem während der Herstellu der Zusammensetzungen durch Mischen der Komponenten vor einer vorzeitigen Polymerisation schütz sollen. Hierzu werden beispielsweise Hydrochlinon, Hydrochlinonderivate, p-Methoxyphenol, β-Naphthole oc sterisch gehinderte Phenole wie z.B. 2,6-Dittert-butyl)-p-kresol verwendet. Weiter können geringe Meng von UV-Absorberm zugesetzt werden, wie z.B. solche vom Benztriazol-, Benzophenon- oder Oxalanilld-Ty Ebenso lassen sich Lichtschutzmittel vom Typus sterisch gehinderter Amine (HALS) zusetzen. Zur Ernöhung der Dunkellagerstebilität können Kupterverbindungen, wie Kuptermaphthenat, -stearat, ot octoat, Phosphorverbindungen, wie Triphenylphosphin, Tributylphosph	ler egserser eer gergeer eer de eer geserser gergeer eer gergeer eer gergeer eer gergeer eer	35 40 45 50
zugegeben werden, bezogen auf die Komponente (a). Die Wahl des Lösungsmittels und die Konzentration richtet sich hauptsächlicht nach der Art de Zusammensetzung und nach dem Beschichtungsverfahren. Die Zusammensetzung wird mittels bekannt Beschichtungsverfahren auf ein Substrat gleichförmig aufgebracht, z.B. durch Tauchen, Räkelbeschichtun Vorhanggiessverfahren, Elektrophorese, Aufpinseln, Sprayen oder Reverseroll-Beschichtung. Die Auftrag menge (Schichtdicke) und Art des Substrates (Schichtträger) sind abhängig vom gewünschten Applikation gebiet. Als Schichtträger photographische Informationsaufzeichnung dienen z.B. Follen aus Polyeste Celluloseacetat oder mit Kunststoff beschichtete Papiere; für Offsetdruckformen speziell behandelt Aluminium und für die Herstellung gedruckter Schaltungen kupferkaschlerte Laminate. Die Schichtdicken in photographische Materialien und Offsetdruckformen betragen im allgemeinen a. 0,5 bis ca. 10 µm; 1 gedruckte Schaltungen im allgemeinen 1 bis ca. 100 µm. Bei Mitverwendung von Lösungsmitteln werden die nach dem Beschichten entremt. Photohärtbare Zusammensetzungen, wie sie für die verschiedenen Zwecke verwendet werden, enthalt meist ausser den photopolymerisierbaren Verbindungen und den Photoinitiatoren eine Reihe sohstig Zusätze. So ist es vielfach üblich, thermische Inhibitoren zuzusetzen, die vor allem während der Herstellu der Zusammensetzungen durch Mischen der Komponenten vor einer vorzeitigen Polymerisation schütz sollen. Hierzu werden beispielsweise Hydrochlinon, Hydrochlinonderivate, p-Methoxyphenol, β-Naphthole oc sterisch gehinderte Phenole wie z.B. 2,6-Dittert-butyl)-p-kresol verwendet. Welter können geringe Meng von UV-Absorberm zugesetzt werden, wie z.B. solche vom Benztriazol-, Benzophenon- oder Oxalanilld-Ty-Ebenso lassen sich Lichtschutzmittel vom Typus sterisch gehinderter Amine (HALS) zusetzen. Zur Ernöhung der Dunkellagerstabilität können Kupterverbindungen, wie Kuptermaphthenat, -stearat, ot octoat, Phosphorverbindungen, wie Triphenylphosphin, Tributylphosph	ler egserser eer gergeer eer de eer geserser gergeer eer gergeer eer gergeer eer gergeer eer	35 40 45 50

Weltere übliche Zusätze sind z.B. Füllstoffe, Pigmente, Farbstoffe, Haft-, Netz- und Verlaufmittel.

Grosse Bedeutung hat die Photohärtung für Druckfarben, da die Trocknungszeit des Bindemittels ein massgeblicher Faktor für die Produktionsgeschwindigkeit graphischer Erzeugnisse ist und in der Grössenordnung von Bruchtellen von Sekunden liegen soll. Insbesondere für den Siebdruck sind UV-härtbare Druckfarben von Bedeutung.

Gut geeignet sind die erfindungsgemässen photohärtbaren Zusammensetzungen auch zur Herstellung von Druckplatten, insbesondere Flexodruckplatten, Hierbei werden z.B. Gemische von löslichen linearen Polyamiden oder von Styrol-Butadien-Kautschuk mit photopolymerislerbaren Monomeren, beispielsweise Acrylamiden oder Acrylaten, und einem Photoinitiator verwendet. Filme und Platten aus diesen Systemen werden über das Negativ (oder Positiv) der Druckvorlage belichtet und die ungehärteten Anteile anschliessend mit einem Lösungsmittel elulert.

Ein weiteres Einsatzgebiet der Photohärtung ist die Metallbeschichtung, beispielsweise bei der Lackierung von Blechen für Tuben, Dosen oder Flaschenverschlüssen, sowie die Photohärtung von Kunststoffbeschichtungen, beispielsweise von Fussboden- oder Wandbelägen auf PVC-Basis.

Beispiele für die Photohärtung von Papierbeschichtungen sind die farbiose Lackierung von Etiketten, Schallplatten-Hüllen oder Buchumschlägen.

Wichtig ist auch die Verwendung der photohärtbaren Zusammensetzungen für Abbildungsverfahren und zur optischen Herstellung von Informationsträgern. Hierbei wird die auf dem Träger aufgebrachte Schicht (nass oder trocken) durch eine Photomaske mit kurzweiligem Licht bestrahlt und die unbelichteten Stellen der Schicht durch Behandlung mit einem Lösungsmittel (= Entwickler) entfernt. Die belichteten Stellen sind vernetzt-polymer und dadurch unlöslich und bleiben auf dem Träger stehen. Bei entsprechender Anfärbung entstehen sichtbare Bilder. Ist der Träger eine metallisierte Schicht, so kann das Metall nach dem Belichten und Entwickeln an den unbelichteten Stellen weggeätzt oder durch Galvanisieren verstärkt werden. Auf diese Weise lassen sich gedruckte Schaltungen und Photoresists herstellen.

Zur Belichtung eignen sich Lichtquellen mit hohem Anteil an kurzwelligem Licht. Hierfür stehen heute entsprechende technische Vorrichtungen und verschiedene Lampenarten zur Verfügung. Beispiele sind Kohlelichtbogenlampen, Xenonlichtbogenlampen, Quecksilberdampflampen, Metall-Halogenlampen, Fluoreszenzlampen, Argonlampen oder photographische Flutlichtlampen. Neuerdings werden auch Laserlichtquellen verwendet. Diese haben den Vorteil, dass keine Photomasken notwendig sind; der gesteuerte Laserstrahl schreibt direkt auf die photohärtbare Schicht.

Die erfindungsgemässen Titanocene sind mit den Komponenten der photohärtbaren Zusammensetzungen gut vermischbar bzw. in der Zusammensetzung gut löslich, wodurch eine hohe Lichtempfindlichkeit erzielt werden kann.

Die nachfolgenden Beispiele erläutern die Erfindung näher.

Beispiel 1:

a) Diethylenglykol-mono-butyl-mono-(2,3,5,6-tetrafluor-4-chlor)phenylether

23 g Na-Metall (1 Mol) werden fein geschnitten in 500 ml Diethylenglykol-monobutylether eingetragen, wobei die Temperatur des Gemisches durch externe Kühlung bei ca. 45°C gehalten wird. Nach dem Abklingen der Reaktion wird auf 50°C erwärmt, bis das Natrium vollständig gelöst ist. Die braune Lösung wird innert ca. 1 Stunde unter schwacher Kühlung bei 40-45°C zu 233 g Chlor-pentafluorbenzol (1,16 Mol) zulaufen gelassen. Das Reaktionsgemisch wird auf 70°C erwärmt und während ca. 7 Stunden bei dieser Temperatur gehalten. Nach dem Erkalten wird es auf 1 ! Wasser ausgetragen und mit 1 l Methylenchlorid ausgezogen. Die organische Phase wird abgetrennt, mit Na₂SO₄ getrocknet und das Lösungsmittel im Wasserstrahlvakuum abdestilliert. Der Rückstand wird im Hochvakuum rektifiziert und die bei 100-104°C und 3 mbar siedende Fraktion aufgefangen. Man erhält 280 g eines klaren, farblosen Oels.

b) Bis(cyclopentadienyl)-bis-[4-(1',4',7'-trioxa-n-undec-1-yl)(2,3,5,6-tetrafluorphenyl))titanocen
51,7 g Diethylengtykol-mono-butyl-mono(2,3,5,6-tetrafluoro-4-chlor)-phenyläther (0,15 Mol) werden in 400
ml absolutem Diethylether unter Argon-Schutzgas gelöst und auf -75°C abgekühlt. Nach dem Zutropfen von
103 ml Lithiumbutyl-Hexan-Lösung (1,6 molar) wird 15 Minuten bei -75°C gerührt. Hierauf setzt man 18,7 g
Biscyclopentadienyltitandichlorid (0,075 Mol) als Pulver zu und entfernt die Kühlung. Die Mischung erwärmt
sich Innert ca. 2 Stunden auf Raumtemperatur, wobei eine orangerote trübe Lösung entsteht. Das
Reaktionsgemisch wird auf 1 l Wasser aufgegossen und in Portionen mit total 600 ml Ethylacetat ausgezogen.
Die organische Phase wird mit Na₂SO₄ getrocknet und am Wasserstrahlvakuum eingedampft. Der Rückstand
besteht aus 58,0 g eines klaren orangeroten Oels. Dieses Oel kann durch Chromatographie über Kieselgel mit
einem 2:1 Hexan-Ethergemisch als Laufmittel gereinigt werden. Das nach dem Abdestillieren der
Lösungsmittel resultierende klare zählflüssige orange Oel bleibt auch bei längerem Stehen flüssig.

Beispiel 2:

50

Ein analoges Produkt mit ähnlichen Eigenschaften kann hergestellt werden, wenn als Titanverbindung eine äquivalente Menge Bis(methylcyclopentadienyl)titandichlorid verwendet und sonst nach obigem Verfahren gearbeitet wird. Man erhält Bis(methylcyclopentadienyl)bis-[4-(1',4',7'-trioxa-n-undec-1-yl)(2,3,5,6-tetrafluorphenyl)titanocen als klares zähflüssiges oranges Oel, das auch bei längerem Stehen flüssig bleibt.

Beispiel 3:

Bis(cyclopentadienyl)-bis[4-(1',4',7',10'-tetracxadodecyl)-2,3,5,6-tetrafluorphenyl]-titan

Wie in Beispiel 1 beschrieben wird Triethylenglykol-monoethylether mit Natrium und Chlorpentafluorbenzol umgesetzt. Der erhaltene Triethylenglykol-monoethyl-mono(2,3,5,6-tetrafluor-4-chlorphenyl)ether siedet bei 8 mbar bei 124-128°C. 54,1 g dieses Ethers werden wie in Beispiel 1 beschrieben mit 103 ml Lithiumbutyl-Hexaniösung und 18,7 g Bis(cyclopentadienyl)titandichlorid umgesetzt. Nach chromatographischer Reinigung erhält man die Titelverbindung als klares viskoses orangefarbenes Oel, das auch bei längerem Stehen flüssig bleibt.

Beispiel 4: Photohärtung eines Acrylat-Gemisches

Es wird eine photohärtbare Zusammensetzung hergestellt durch Mischen der folgenden Komponenten: 50 Telle eines Oligourethan-acrylates (Actilan® AJ 20).

15

25

20 Telle Trimethylolpropan-triacrylat

15 Telle Tripropylenglykol-dlacrylat

15 Teile N-Vinylpyrrolldon

0,5 Telle eines Verlaufshilfsmittels auf Sillcon-Basis (BYK® 300, Byk-Mallinckrodt, BRD)

Portionen dieser Zusammensetzung werden mit der in der folgenden Tabelle angegebenen Menge an Photolnitiator oder Initiatorgemisch vermischt. Bei den Initiatorgemischen handelt es sich um Lösungen eines Titanocens in einem flüssigen Initiator vom Ketal-Typ der Formel A:

Alle Operationen werden unter Rotlicht oder Gelblicht ausgeführt.

Die mit Initiator versetzten Proben werden in einer Stärke von 100 μm auf Aluminiumbleche (10 x 15 cm) aufgetragen. Auf die flüssige Schicht wird eine 76 μm dicke Polyesterfolle gelegt und auf diese ein standardisiertes Testnegativ mit 21 Stufen verschiedener optischer Dichte (Stouffer-Keil) gelegt. Derüber wird eine zweite Polyesterfolle gelegt und das so erhaltene Laminat auf einer Metaliplatte fixiert. Die Probe wird dann mit einer 5 KW-Metalihalogenid-Lampe im Abstand von 30 cm belichtet und zwar in einer ersten Testrelhe 5 Sekunden und in einer zweiten Testrelhe 10 Sekunden und in einer dritten Testrelhe 15 Sekunden. Nach der Belichtung werden die Follen und die Maske entfernt, die belichtete Schicht in einem Ethanolbad 15 Sekunden entwickeit und anschliessend bei 60°C 5 Min getrocknet. Die Empfindlichkeit des verwendeten initiatorsystems wird durch die Angabe der letzten klebefrei abgebildeten Keilstufe charakterisiert. Je höher die Zahl der Stufen ist, desto empfindlicher ist das System. Eine Erhöhung um zwei Stufen bedeutet dabel etwa eine Verdopplung der Härtungsgeschwindigkeit. Die Ergebnisse sind in Tabelle 1 dargesteilt.

Tabelle 1

Titanocen- Initiator	Ketal- Initiator	Zahl 5s	der abge 10s	bildeten 15s :	Stufen nach Belichtung	50
0,2 % Beispiel 1	-	11	1:2	15		
0,2 % Beispiel 1	1,8 % A	11	14	16		
0,2 % Beispiel 2	· -	. 9	11	13,	w.	55

Beispiel 5

Es wird eine photohartbare Zusammensetzung durch Mischen der folgenden Komponenten hergestellt: 150,3 Teile Styrol/Monomethylmaleinat-Copolymer als 30%-lge Lösung in Aceton, 48,3 Teile Trimethylolpropantriacrylat

6.4 Teile Polyethylenglykoldiacrylat

0.16 Teile Kristallviolett.

Es wird welter wie in Beispiel 4 verfahren. Die Entwicklung wird mit einer wässrig-alkalischen Lösung der

folgenden Zusammensetzung vorgenommen:
1000 g Wasser
15 g Natriummetasilikat
0,16 g Kallumhydroxid
3 g Polyethylenglykol 6000
0,5 g Lävulinsäure
Die Ergebnisse sind in Tabelle 2 dargestellt.

_

10

Tabelle 2

. 15	Titanocen-Initiator	Zahl der abgebildeten Stufen nach				
. 10		20s	40s		Belichtung	·
	0,2 % Beispiel 1	11	14	15		
20	0,2 % Beispiel 2	10	12	14		•

Patentansprüche

1. Titanocene der Formel I

 $\begin{array}{c}
\mathbb{R}^{1} & \xrightarrow{\mathbb{R}^{2}} \\
\mathbb{R}^{3} & & & \\
\end{array}$

35

40

45

50

55

60

65

30

worln beide R¹ unabhängig vonelnander gegebenenfalls ein- oder mehrfach durch C₁-C₁a-Alkyl oder -Alkoxy, C₂-C₁a-Alkenyl, C₅-C₂-Cycloalkyl, C₅-C₁a-Aryl, C₂-C₁a-Aralkyl, Cyan oder Hatogen substituiertes Cyclopentadienyle, Indenyle, 4,5,6,7-Tetrahydroindenylebedeuten oder beide R¹ zusammen für einen gegebenenfalls wie zuvor substituierten Rest der Formel II

(11)

. st

stehen, worin X + CH₂+_n mit n = 1, 2 oder 3, gegebenenfalls durch Phenyl substituiertes Alkyliden mit 2 bis 12 C-Atomen, Cycloalkyliden mit 5 bis 7 Ringkohlenstoffatomen, SiR⁴₂ oder SnR⁴₂ ist, und R⁴ C₁-C₁₂-Alkyl, C₅-C₁₂-Cycloalkyl, C₆-C₁₆-Aryl oder C₇-C₁₆-Aralkyl bedeutet,

R² einen 6-gliedrigen carbocyclischen oder 5- oder 6-gliedrigen heterocyclischen aromatischen Ring bedeutet, der in mindestens einer der beiden ortho-Stellungen zur Metallkohlenstoffbindung durch Fluoratome substituiert ist und wobei der aromatische Ring weitere Substituenten enthalten kann, oder R² und R³ zusammen einen Rest der Formei III bedeuten, —Q—Y—Q— (III)

in dem Q für einen carbocyclischen aromatischen Ring steht, wobei die beiden Bindungen jeweils in Orthostellung zur Y-Gruppe stehen und die Metastellung zur Y-Gruppe jeweils durch ein Fluoratom substitulert ist und wobei Q weitere Substituenten enthalten kann, und Y CH₂, Alkyliden mit 2 bis 12 C-Atomen, Cycloalkyliden mit 5 bis 7 Ringkohlenstoffatomen, eine direkte Bindung, NR⁴, O, S, SO, SO₂, CO, SIR⁴₂ oder SnR⁴₂ bedeutet und R⁴ die zuvor angegebene Bedeutung hat,

R³ die Bedeutung von R² hat oder Alkinyl, substituiertes oder unsubstituiertes Phenylalkinyl, N₃, CN, SiR⁴₃ oder SnR⁴₃ bedeutet, wobei die Titanocene dadurch gekennzeichnet sind, dass R² durch mindestens einen gegebenenfalls verätherten oder veresterten Polyoxaalkylenrest enthält, wobei dieser Rest entweder direkt oder über eine Brückengruppe an den aromatischen Ring gebunden sein kann.

 Titanocene gemäss Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass R1 Cyclopentadienyle oder Methylcyclopentadienyle ist.

3. Titanocene gemäss Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass R2 und R3 die gleiche Bedeutung

haher

- 4. Titanocene gemäss Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass R² und R³ für 2,6-Difluorphen-1-yl stehen, an das mindestens ein gegebenenfalls verätherter Polyoxaalkylenrest direkt oder über eine Brückengruppe gebunden ist, und das weitere 1 oder 2 gleiche oder verschiedene Substituenten enthalten kann.
- 5. Titanocene gemäss Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, dass in Formel I beide R^1 Cyclopentadienyle oder durch C_1 - C_4 -Alkyl substituiertes Cyclopentadienyle und R^2 und R^3 Reste der Formel

sind, worin ${\rm R}^5$ und ${\rm R}^6$ unabhängig voneinander H, F, Cl oder Br bedeuten und ${\rm R}^7$ gegebenenfalls veräthertes oder verestertes Polyoxaalkylen ist, das direkt oder über eine Brückengruppe an den Phenylring gebunden ist.

15

25

30

- Titanocene gemäss Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass der Polyoxaalkylenrest mit C₁-C₁₈-Alkyl veräthert oder mit C₁-C₁₈-Acyl verestert ist.
- 7. Titanocene gemäss Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass der Polyoxaalkylenrest 1 bis 20 Oxaalkyleneinheiten enthält.
- 8. Titanocene gemäss Anspruch 1, dadurch gekennzelchnet, dass das Alkylen im Polyoxaalkylenrest 2 bis 6 C-Atome enthält.
- 9. Titanocene gemäss Anspruch 8, dadurch gekennzeichnet, dass das Alkylen Ethylen oder 1,2-Propylen ist.
- 10. Titanocene gemäss Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass es sich bei der Brückengruppe um eine Gruppe der Formel -S-, -O-,

$$-0SO_2-$$
, $-CH_2O-$, $-CH(CH_3)O-$, $-SO_2-$, $-C(O)O-$, $-CH_{O-}$, $-N$, $-NR^{10}-$,

-NCH₂CH₂N, -NR¹⁰CH₂CH₂N, -NCH₂CH₂-NR¹⁰-, -NR¹⁰CH₂CH₂NR¹⁰-, -CH₂N, -CH₂NR¹⁰-, -CH₂COO-, -CONR¹⁰-, -CH(CONR¹⁰-)₂,

 $-CH_2CONR^{10}-$, -CON, -OC(0)O-, $-N(R^{10})-COO-$, $-CH_2N(R^{10})-COOH-$,

 $-N(R^{10})-CONH-$, $-CH_2N(R^{10})-CONH-$, $C_nH_{2n}OC(0)C_mH_{2m}O-mit n = 0$,

1 oder 2 und m = 1-6, $-C_nH_{2n}OSiR_{3-y}^{11}O_y$ mit n = 0, 1 oder 2 und

y = 1-3, $-OCH_2CH_2OSiR_{3-y}^{11}O_{y}$, $-COOSiR_{3-y}^{11}O_{y}$ oder $-CH_2COOSiR_{3-y}^{11}O_{y}$ mit

y = 1-3 handelt, worin R^{10} H, C_1-C_{10} -Alkyl oder C_1-C_{10} -Acyl und R^{11} C_1-C_{12} -Alkyl oder Phenyl sind.

11. Titanocene gemäss Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass der Polyoxaalkylenrest der Formel

$$(-C_zH_{2z}O) - R^g$$
,

entspricht, worin z eine Zahl von 2-6, o eine Zahl von 1 bls 20 und R^g H oder C₁-C₁₈-Alkyl bedeuten.

12. Titanocene gemäss den Ansprüchen 10 und 11, dadurch gekennzelchnet, dass R^g C₁-C₁₂-Alkyl, R¹⁰.

H oder C₁-C₁₂-Alkyl and R¹¹-C₁-C₁₂-Alkyl, R¹⁰-Alkyl and R¹¹-C₁₂-Alkyl, R¹⁰-Alkyl and R¹¹-C₁₂-Alkyl, R¹⁰-Alkyl and R¹¹-C₁₂-Alkyl and R¹¹-C₁₂-Alkyl and R¹¹-C₁₂-Alkyl and R¹¹-C₁₂-Alkyl and R¹⁰-C₁₂-Alkyl an

H oder C₁-C₁₂-Alkyl und R¹¹ C₁-C₁₆-Alkyl sind, z für eine Zahl von 2 bis 4 und o für eine Zahl von 2 bis 6 stehen.

13. Titanocene gemäss Anspruch 12, dadurch gekennzeichnet, dass der Polyoxaalkylenrest veräthert ist und zusammen mit der Brückengruppe einer der Formeln

$$-O-(CH_2CH_2O-)_O-R^9$$

$$-N[(CH_2CH_2-O-)_O-R^9]_2$$

$$-NR^{1}$$
 (CH_2CH_2O) R^9

15

30

40

45

50

55

60

65

entspricht, worin H^9 C₁-C₁₂-Alkyl bedeutet, H^{10} H oder C₁-C₆-Alkyl darstellt und o für eine Zahl von 2 bis 6 steht.

14. Titanocene gemäss Anspruch 1 der Formel I, worin R¹ Cyclopentadienyle oder Methylcyclopentadienyle ist und R² und R³ Reste der Formel

sind, worin R⁵ und R⁶ Wasserstoff oder Fluor bedeuten, o eine Zahl von 2 bis 6 bedeutet und R⁹ C₁-C₁₂-Alkyl bedeutet.

15. Titanocene gemäss Anspruch 14, worin R⁵ und R⁶ Fluor sind.

16. Verfahren zur Herstellung von Titanocenen der Formel 1 gemäss Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass man 1 Mol einer Verbindung der Formel III

worin R¹ die in Anspruch 1 angegebene Bedeutung hat und Z für Halogen, besonders Chlor, steht, entweder mit ein Mol LiR² oder LiR³ und danach mit ein Mol LiR³ bzw. LiR² umsetzt, oder mit 2 Mol LiR² umsetzt, wobei R² die in Anspruch 1 angegebene Bedeutung hat und R³ Alkinyl, unsubstituiertes oder substituiertes Phenylalkinyl, N₃, CN, SiR⁴₃oder Sn⁴₃ ist, und danach die Verbindungen der Formel I in an sich bekannter Weise isoliert.

17. Durch Strahlung polymerisierbare Zusammensetzung, enthaltend (a) mindestens eine nichtflüchtige, monomere, oligomere oder polymere Verbindung mit mindestens einer polymerisierbaren äthylenisch ungesättigten Doppelbindung und (b) mindestens ein Titanocen der Formel I nach Anspruch 1 als Photoinitiator.

18. Zusammensetzung gemäss Anspruch 17, dadurch gekennzeichnet, dass zusätzlich mindestens ein Photolnitiator (c) enthalten ist.

19. Zusammensetzung gemäss Anspruch 18, enthaltend ein Benzilketal, ein 4-Aroyl-1,3-dioxolan, ein Dialkoxyacetophenon, ein α -Hydroxy-oder α -Aminoacetophenon oder Mischungen davon als zusätzlichen Photoinitiator.

20. Verwendung einer Zusammensetzung gemäss Anspruch 18 zur Herstellung von Lacken, Druckfarben, Druckplatten, Resistmaterialien sowie als Bildaufzeichnungsmaterial.

 Beschichtetes Substrat, das auf mindestens einer Oberfläche mit einer Zusammensetzung gemäss Anspruch 17 oder 18 beschichtet ist.

22. Verfahren zur photographischen Herstellung von Reliefabbildungen, dadurch gekennzeichnet, dass

man ein beschichtetes Substrat gemäss Anspruch 21 bildmässig belichtet und die unbelichteten Anteile danach mit einem Lösungsmittel entfernt.

23. Verwendung von Titanocenen der Formel I gemäss Anspruch 1 alleine oder zusammen mit anderen Initiatoren als Photoinitiatoren für die Photopolymerisation von nicthflüchtigen monomeren, oligomeren oder polymeren Verbindungen mit mindestens einer polymerislerbaren ethylenisch ungesättigten Doppelbindung.

24. Flüssiges Photoinitiatorengemisch, enthaltend einen Photoinitiator vom Typ der Benzilketale, 4-Aroyl-1,3-dioxolane, Dialkoxyacetophenone, α-Hydroxyacetophenone, α-Aminoacetophenone oder Mischungen hiervon und ein Titanocen der Forme I gemäss Anspruch 1.

Patentansprüche für die folgenden Vertragsstaaten: AT, ES

1. Verfahren zur Herstellung von Titanocenen der Formei I

$$\begin{array}{ccc}
R^1 & & \\
R^1 & & \\
R^2 & & \\
R^3
\end{array} \tag{1},$$

worin belde R¹ unabhängig voneinander gegebenenfalls ein- oder mehrfach durch C₁-C₁8-Alkyl oder -Alkoxy, C₂-C₁8-Alkenyl, C₅-C₂-Cycloalkyl, C6-C₁6-Aryl, C7-C₁6-Aralkyl, Cyan oder Halogen substitutertes Cyclopentadlenyle, Indenyle, 4,5,6,7-Tetrahydroindenylebedeuten oder belde R¹ zusammen für einen gegebenenfalls wie zuvor substituterten Rest der Formel II

15

25

stehen, worin $X \leftarrow CH_2 \rightarrow_n$ mit n=1,2 oder 3, gegebenenfalls durch Phenyl substituiertes Alkyliden mit 2 bis 12 C-Atomen, Cycloalkyliden mit 5 bis 7 Ringkohlenstoffatomen, SiR^4_2 oder SnR^4_2 ist, und R^4 C_1 - C_{12} -Alkyl, C_6 - C_{12} -Cycloalkyl, C_6 - C_{16} -Aryl oder C_7 - C_{16} -Aralkyl bedeutet,

R² einen 6-gilledrigen carbocyclischen oder 5- oder 6-gliedrigen heterocyclischen aromatischen Ring bedeutet, der in mindestens einer der beiden ortho-Stellungen zur Metalikohlenstoffbindung durch Fluoratome substituiert ist und wobei der aromatische Ring weltere Substituenten enthalten kann, oder R² und R³ zusammen einen Rest der Formel III bedeuten, —Q—Y—Q— (III)

in dem Q für einen carbocycilschen aromatischen Ring steht, wobel die belden Bindungen jeweils in Orthostellung zur Y-Gruppe stehen und die Metastellung zur Y-Gruppe jeweils durch ein Fluoratom substituiert ist und wobel Q weitere Substituenten enthalten kann, und Y CH₂, Alkyliden mit 2 bis 12 C-Atomen, Cycloalkyliden mit 5 bis 7 Ringkohlenstoffatomen, eine direkte Bindung, NR⁴, O, S, SO, SO₂, CO, SiR⁴₂ oder SnR⁴₂ bedeutet und R⁴ die zuvor angegebene Bedeutung hat,

R³ die Bedeutung von R² hat oder Alkinyl, substituiertes oder unsubstituiertes Phenylalkinyl, N₃. CN. SIR⁴₃ oder SnR⁴₃ bedeutet, wobei die Titanocene dadurch gekennzeichnet sind, dass R² durch mindestens einen gegebenenfalls verätherten oder veresterten Polyoxaalkylenrest enthält, wobei dieser Rest entweder direkt oder über eine Brückengruppe an den aromatischen Ring gebunden sein kann, dadurch gekennzeichnet, dass man 1 Mol einer Verbindung der Formel III

worin Z für Halogen, besonders Chlor, steht, entweder mit ein Mol LiR² oder LiR³ und danach mit ein Mol LiR³ bzw. LiR² umsetzt, oder mit 2 Mol LiR² umsetzt und danach die Verbindungen der Formel I in an sich bekannter Weise isoliert.

2. Durch Strahlung polymerisierbare Zusammensetzung, enthaltend (a) mindestens eine nichtflüchtige, monomere, oligomere oder polymere Verbindung mit mindestens einer polymerlsierbaren äthylenisch ungesättigten Doppelbindung und (b) mindestens ein Titanocen der Formel I nach Anspruch 1 als Photoinitiator.

 Zusammensetzung gemäss Anspruch 2, dadurch gekennzelchnet, dass zusätzlich mindestens ein Photoinitiator (c) enthalten ist.

 Zusammensetzung gemäss Anspruch 3, enthaltend ein Benzilketal, ein 4-Aroyl-1,3-dioxolan, ein Dialkoxyacetophenon, ein α-Hydroxy-oder α-Aminoacetophenon oder Mischungen davon als zusätzli-

0 255 486

chen Photoinitiator.

- 5. Verwendung einer Zusammensetzung gemäss Anspruch 3 zur Herstellung von Lacken, Druckfarben, Druckplatten, Resistmateriallen sowie als Bildaufzeichnungsmaterial.
- Beschichtetes Substrat, das auf mindestens einer Oberfläche mit einer Zusammensetzung gemäss Anspruch 2 oder 3 beschichtet ist.
- 7. Verfahren zur photographischen Herstellung von Reliefabbildungen, dadurch gekennzelchnet, dass man ein beschichtetes Substrat gemäss Anspruch 6 bildmässig belichtet und die unbelichteten Anteile danach mit einem Lösungsmittel entfernt.
- 8. Verwendung von Titanocenen der Formel I gemäss Anspruch 1 alleine oder zusammen mit anderen Initiatoren als Photoinitiatoren für die Photopolymerisation von nichtflüchtigen monomeren, oligomeren oder polymeren Verbindungen mit mindestens einer polymerisierbaren ethylenisch ungesättigten Doppelbindung.
- 9. Flüssiges Photoinitiatorengemisch, enthaltend einen Photoinitiator vom Typ der Benzilketale, 4-Arcyl-1,3-dioxolane, Dialkoxyacetophenone, α-Hydroxyacetophenone, α-Aminoacetophenone oder Mischungen hiervon und ein Titanocen der Formel I gemäss Anspruch 1.